

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 4 月 10 日(10.04.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/054539 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 51/00 (2006.01) C08F 290/04 (2006.01)
C08F 265/06 (2006.01) C08K 3/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/076335
- (22) 国際出願日: 2013 年 9 月 27 日(27.09.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-221715 2012 年 10 月 3 日(03.10.2012) JP
- (71) 出願人: 大日本印刷株式会社(DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小倉 教弘(OGURA, Michihiro); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP). 村田 智基(MURATA, Tomoki); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP). 大森 吉信(OMORI, Yoshinobu); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP). 喜 直信(YOSHI, Naonobu); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP). 北條 美貴子(HOJO, Mikiko); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP). 澤田 将

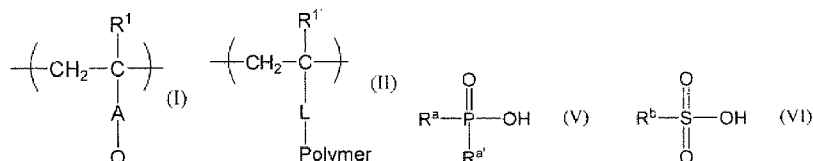
徳(SAWADA, Masanori); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP). 上野 滋弘(UENO, Shigehiro); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP). 薙野 晋介(NAGINO, Shinsuke); 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 岸本 達人, 外(KISHIMOTO, Tatsuhito et al.); 〒1040031 東京都中央区京橋一丁目 1 6 番 1 0 号 オークビル京橋 3 階 東京セントラル特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

[続葉有]

(54) Title: METAL PARTICLE DISPERSION, ARTICLE AND SINTERED FILM USING METAL PARTICLE DISPERSION, AND METHOD FOR PRODUCING SINTERED FILM

(54) 発明の名称: 金属粒子分散体、並びに、当該金属粒子分散体を用いた物品、焼結膜及び焼結膜の製造方法



(57) Abstract: Provided is a metal particle dispersion which has low viscosity, excellent dispersibility and excellent dispersion stability, while being suppressed in sedimentation of the metal particles. This metal particle dispersion contains metal particles, a dispersant and a solvent. The metal particles contain one or more elements that are selected from the group consisting of gold, silver, copper, nickel, platinum, palladium, molybdenum, aluminum, antimony, tin, chromium, lanthanum, indium, gallium and germanium. The dispersant is a graft copolymer which has a constituent unit represented by general formula (I) and a constituent unit represented by general formula (II), and wherein at least some nitrogen moieties contained in the constituent unit represented by general formula (I) form a salt together with at least one compound selected from the group consisting of halogenated hydrocarbons, acidic phosphorus compounds represented by general formula (V) and sulfonic acid compounds represented by general formula (VI). (The symbols in general formula (I), general formula (II), general formula (V) and general formula (VI) are as defined in the description.)

(57) 要約: 低粘度で、分散性、分散安定性に優れ、金属粒子の沈降が抑制された金属粒子分散体を提供する。金属粒子と、分散剤と、溶剤とを含有し、前記金属粒子は、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、及びゲルマニウムよりなる群から選択される 1 種以上を含む金属粒子であり、且つ、前記分散剤は、下記一般式 (I) で表される構成単位と、下記一般式 (II) で表される構成単位とを有し、前記一般式 (I) で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、下記一般式 (V) で表される酸性リン化合物、及び下記一般式 (VI) で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも 1 種とが塩を形成したグラフト共重合体である、金属粒子分散体。(一般式 (I)、一般式 (II)、一般式 (V)、及び一般式 (VI) 中の各符号は、明細書に記載されたとおりである。)

WO 2014/054539 A1



(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：

金属粒子分散体、並びに、当該金属粒子分散体を用いた物品、焼結膜及び焼結膜の製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、金属粒子分散体、並びに、当該金属粒子分散体を用いた物品、焼結膜及び焼結膜の製造方法に関するものである。

背景技術

[0002] 数 nm～数十 nm 程度の粒径を有する微細な金属粒子は、従来の金属材料とは異なる、種々の物理的、化学的特性を示すことから、導電性ペースト、透明導電膜、遮光フィルター、化学センサー、触媒、抗菌材、導光部材、ガスバリア材、光散乱・反射部材、光拡散部材、感光性材料、光電変換素子、蛍光材料、色材等、幅広い分野への応用が期待されている。上記金属粒子は、溶剤中で分散することによりインクやペースト状の金属粒子分散体とすることができる。

[0003] 例えば、透明導電膜や熱線遮蔽膜などの用途として、ITO（スズドープ酸化インジウム）やATO（スズドープ酸化アンチモン）などの金属酸化物からなる金属粒子をマトリックス材料に均一分散した金属粒子分散体が使用されている。この場合、粒径が数十ナノメートルより大きい金属粒子を用いると可視光が散乱して濁って見えてしまうが、数十ナノメートルより小さい金属粒子を用いることにより、光散乱を抑制した透明性の高い光学材料が得られることが期待されている。

[0004] また、金属粒子は、微細化することにより、劇的に融点が低下することが知られている。これは、金属粒子の粒径が小さくなるのに伴って、粒子の比表面積が増加し、表面エネルギーが増大することによるものである。この効果を利用すれば、金属粒子分散体を用いて基材に直接パターンを印刷し、回路パターンを形成する手法において、金属粒子同士の焼結を従来よりも低温

で進行させることができ、従来のフォトレジスト法等と比較して、生産性が飛躍的に向上するとともに、従来用いることが困難であった、耐熱性の低い樹脂基材に対しても、印刷による回路形成が可能となると期待されている。

このように、微細な金属粒子は、金属粒子分散体として広く用いられており、より分散性や分散安定性に優れた金属微粒子分散体が望まれている。

[0005] 特許文献1には、金属酸化物微粒子の分散安定性に優れた手法として、特定の金属酸化物微粒子と、非イオン性の有機分散剤と、バインダーと、有機溶剤とを含有する反射防止フィルム用塗布組成物が記載されている。

[0006] 特許文献2には、インクジェット印刷方式によって、金属光沢に優れた文字や画像を印字又は印刷可能なインク組成物として、金属ナノ粒子をカルボキシル基を有する有機化合物と高分子分散剤を含む保護コロイドで被覆した金属コロイド粒子を用いることが記載されている。

しかしながら、特許文献1及び2の手法は、高濃度の金属粒子を分散する場合に多量の分散剤が必要であり、更なる分散性の向上が求められていた。

[0007] 特許文献3には、特定の金属微粒子と、特定のポリエステル骨格を有する高分子分散剤と、分散媒を含有する金属微粒子分散体が記載されている。

特許文献3によれば、上記特定の高分子分散剤が金属微粒子の分散性に高い効果を示し、しかも後の焼結工程で容易に揮散されると記載されている。しかしながら、後述の比較例で示されるように、特許文献3の手法では、金属微粒子分散体の保存安定性が十分でなく、一定期間保管後には金属粒子の沈降がみられることがあった。

先行技術文献

特許文献

[0008] 特許文献1：特開2005-272755号公報

特許文献2：特開2009-227736号公報

特許文献3：国際公開第2011/040189号パンフレット

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0009] 上述のように、微細な金属粒子が均一に分散された金属粒子分散体が望まれている。しかしながら、一般に金属粒子は比重が高く、沈降しやすいため、分散性、分散安定性が高い分散体を得ることは非常に難しい課題であった。更に、金属粒子の粒径が小さいほど、分散性や分散安定性が良好な分散体を調製することが困難であった。

[0010] 本発明は、このような状況下になされたものであり、分散性、分散安定性に優れ、金属粒子の沈降が抑制された金属粒子分散体、及び、前記本発明に係る金属粒子分散体、又は当該金属粒子分散体を含む組成物の塗膜、成形体、若しくは焼結膜を含む、物品を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0011] 本発明者らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定の金属粒子と特定の分散剤を組み合わせる用いることにより、分散性、分散安定性に優れるとの知見を得た。

本発明は、係る知見に基づいて完成したものである。

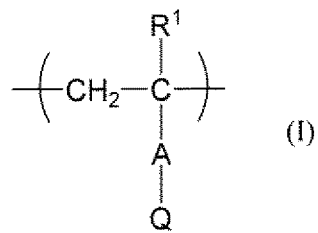
[0012] 本発明に係る金属粒子分散体は、金属粒子と、分散剤と、溶剤とを含有し、

前記金属粒子は、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、及びゲルマニウムよりなる群から選択される１種以上を含む金属粒子であり、且つ、

前記分散剤は、下記一般式（Ⅰ）で表される構成単位と、下記一般式（ⅠⅠ）で表される構成単位とを有し、前記一般式（Ⅰ）で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、下記一般式（Ⅴ）で表される酸性リン化合物、及び下記一般式（ⅤⅠ）で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも１種とが塩を形成したグラフト共重合体であることを特徴とする。

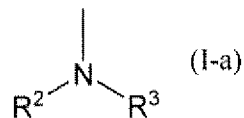
[0013]

[化1]



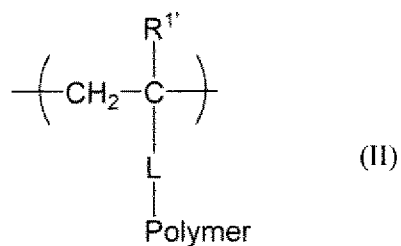
(一般式 (I) 中、A は、直接結合又は 2 価の連結基、R¹ は、水素原子又はメチル基、Q は、下記一般式 (I-a) で表される基、又は、置換基を有していても良い、塩形成可能な含窒素複素環基を表す。)

[0014] [化2]



(一般式 (I-a) 中、R² 及び R³ は、それぞれ独立して、水素原子又はヘテロ原子を含んでもよい炭化水素基を表し、R² 及び R³ は互いに同一であっても異なってもよい。)

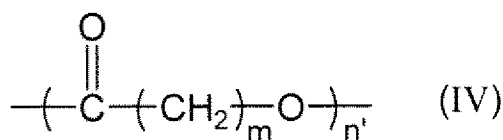
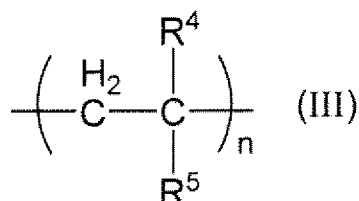
[0015] [化3]



(一般式 (II) 中、R^{1'} は、水素原子又はメチル基、L は、直接結合又は 2 価の連結基、Polymer は、下記一般式 (III) 又は一般式 (IV) で表される構成単位を少なくとも 1 種有するポリマー鎖を表す。)

[0016]

[化4]



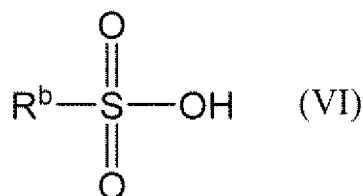
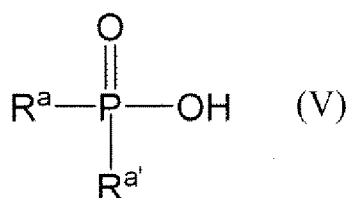
(一般式 (I I I) 及び、一般式 (I V) 中、 R^4 は水素原子又はメチル基であり、 R^5 は炭化水素基、シアノ基、 $\text{---} [\text{CH} (R^6) \text{---CH} (R^7) \text{---O}]_x \text{---} R^8$ 、 $\text{---} [(\text{CH}_2)_y \text{---O}]_z \text{---} R^8$ 、 $\text{---} [\text{CO} \text{---} (\text{CH}_2)_y \text{---O}]_z \text{---} R^8$ 、 $\text{---CO} \text{---O} \text{---} R^9$ 又は $\text{---O} \text{---CO} \text{---} R^{10}$ で示される 1 価の基である。 R^6 及び R^7 は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基である。

R^8 は、水素原子、炭化水素基、 ---CHO 、 $\text{---CH}_2\text{CHO}$ 又は $\text{---CH}_2\text{COOR}^{11}$ で示される 1 価の基であり、 R^9 は、炭化水素基、シアノ基、 $\text{---} [\text{CH} (R^6) \text{---CH} (R^7) \text{---O}]_x \text{---} R^8$ 、 $\text{---} [(\text{CH}_2)_y \text{---O}]_z \text{---} R^8$ 、又は $\text{---} [\text{CO} \text{---} (\text{CH}_2)_y \text{---O}]_z \text{---} R^8$ で示される 1 価の基である。 R^{10} は、炭素数 1 ～ 18 のアルキル基であり、 R^{11} は水素原子又は炭素数 1 ～ 5 のアルキル基を示す。

上記炭化水素基は、置換基を有していてもよい。

m は 1 ～ 5 の整数、 n 及び n' は 5 ～ 200 の整数を示す。 x は 1 ～ 18 の整数、 y は 1 ～ 5 の整数、 z は 1 ～ 18 の整数を示す。)

[0017] [化5]



(一般式 (V) 及び一般式 (V I) 中、 R^a 及び $R^{a'}$ はそれぞれ独立に、水素原子、水酸基、炭化水素基、 $\text{---} [\text{CH} (R^c) \text{---CH} (R^d) \text{---O}]_s \text{---} R^e$ 、 $\text{---} [(\text{CH}_2)_t \text{---O}]_u \text{---} R^e$ 、又は $\text{---O} \text{---} R^{a''}$ で示される 1 価の基である

。 $R^{a'}$ は、炭化水素基、 $-[CH(R^c)-CH(R^d)-O]_s-R^e$ 、 $-[(CH_2)_t-O]_u-R^e$ 、 $-C(R^f)(R^g)-C(R^h)(R^i)-OH$ 、又は、 $-CH_2-C(R^j)(R^k)-CH_2-OH$ で示される1価の基である。

R^b は、炭化水素基、 $-[CH(R^c)-CH(R^d)-O]_s-R^e$ 、 $-[(CH_2)_t-O]_u-R^e$ 、又は $-O-R^{b'}$ で示される1価の基である。 $R^{b'}$ は、炭化水素基、 $-[CH(R^c)-CH(R^d)-O]_s-R^e$ 、又は $-[(CH_2)_t-O]_u-R^e$ で示される1価の基である。

R^c 及び R^d は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基であり、 R^e は、水素原子、炭化水素基、 $-CHO$ 、 $-CH_2CHO$ 、又は $-CH_2COOR^l$ で示される1価の基であり、 R^l は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基である。

R^f 、 R^g 、 R^h 、 R^i 、 R^j 及び R^k は、それぞれ独立に、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基であって、 R^f 及び R^h は、互いに結合して環構造を形成してもよい。上記環状構造を形成した場合、置換基 R^n を有していてもよく、 R^n は、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基である。

R^a 、 $R^{a'}$ 、及び R^b において、炭化水素基はそれぞれ、置換基を有していてもよい。

s は1～18の整数、 t は1～5の整数、 u は1～18の整数を示す。)

[0018] 本発明の金属粒子分散体においては、前記金属粒子の平均一次粒径が5～200nmであることが、好ましい。

[0019] また、本発明は、前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜、成形体又は焼結膜を含む、物品を提供する。

発明の効果

[0020] 本発明によれば、分散性、分散安定性に優れ、金属粒子の沈降が抑制された金属粒子分散体及び、前記本発明に係る金属粒子分散体、又は当該金属粒子分散体を含む組成物の塗膜、成形体、若しくは焼結膜を含む、物品を提供

することができる。

図面の簡単な説明

[0021] [図1]図 1 は、本発明に係る物品の一例を示す概略図である。

[図2]図 2 は、本発明に係る物品の別の一例を示す概略図である。

[図3]図 3 は、本発明に係る物品の別の一例を示す概略図である。

発明を実施するための形態

[0022] 以下、本発明に係る金属粒子分散体、及び物品について説明する。

なお、本発明において光には、可視及び非可視領域の波長の電磁波、さらには放射線が含まれ、放射線には、例えばマイクロ波、電子線が含まれる。具体的には、波長 $5\ \mu\text{m}$ 以下の電磁波、及び電子線のことをいう。また本発明において（メタ）アクリルとは、アクリル又はメタクリルのいずれかであることを意味し、（メタ）アクリレートとは、アクリレート又はメタクリレートのいずれかであることを意味する。

[0023] [金属粒子分散体]

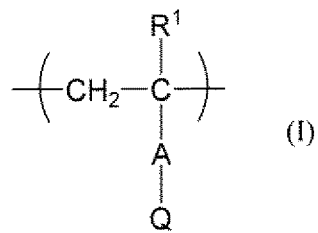
本発明に係る金属粒子分散体は、金属粒子と、分散剤と、溶剤とを含有し、

前記金属粒子は、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、及びゲルマニウムよりなる群から選択される 1 種以上を含む金属粒子であり、且つ、

前記分散剤は、下記一般式（Ⅰ）で表される構成単位と、下記一般式（ⅠⅠ）で表される構成単位とを有し、前記一般式（Ⅰ）で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、下記一般式（Ⅴ）で表される酸性リン化合物、及び下記一般式（ⅤⅠ）で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも 1 種とが塩を形成したグラフト共重合体であることを特徴とする。

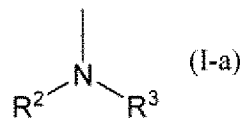
[0024]

[化6]



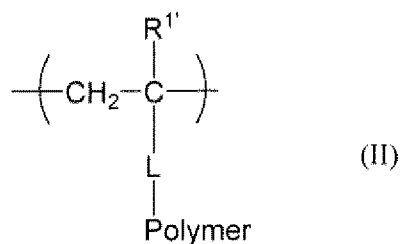
(一般式 (I) 中、A は、直接結合又は 2 価の連結基、R¹ は、水素原子又はメチル基、Q は、下記一般式 (I-a) で表される基、又は、置換基を有していても良い、塩形成可能な含窒素複素環基を表す。)

[0025] [化7]



(一般式 (I-a) 中、R² 及び R³ は、それぞれ独立して、水素原子又はヘテロ原子を含んでもよい炭化水素基を表し、R² 及び R³ は互いに同一であっても異なってもよい。)

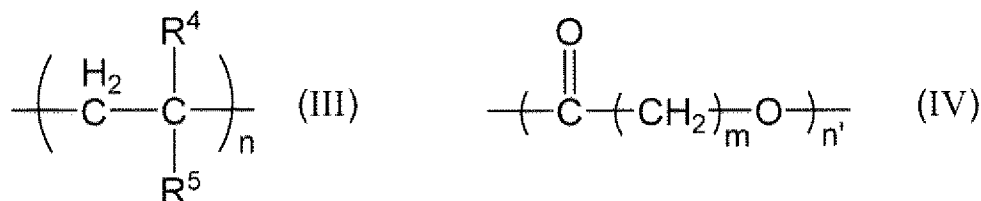
[0026] [化8]



(一般式 (II) 中、R^{1'} は、水素原子又はメチル基、L は、直接結合又は 2 価の連結基、Polymer は、下記一般式 (III) 又は一般式 (IV) で表される構成単位を少なくとも 1 種有するポリマー鎖を表す。)

[0027]

[化9]



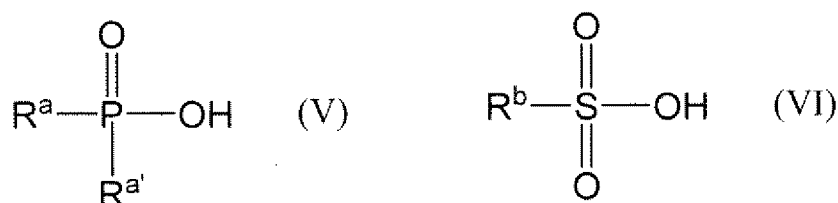
(一般式 (I I I) 及び、一般式 (I V) 中、 R^4 は水素原子又はメチル基であり、 R^5 は炭化水素基、シアノ基、 $-\text{[CH}(R^6)-\text{CH}(R^7)-\text{O}]_x-\text{R}^8$ 、 $-\text{[(CH}_2)_y-\text{O}]_z-\text{R}^8$ 、 $-\text{[CO}-(\text{CH}_2)_y-\text{O}]_z-\text{R}^8$ 、 $-\text{CO}-\text{O}-\text{R}^9$ 又は $-\text{O}-\text{CO}-\text{R}^{10}$ で示される1価の基である。 R^6 及び R^7 は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基である。

R^8 は、水素原子、炭化水素基、 $-\text{CHO}$ 、 $-\text{CH}_2\text{CHO}$ 又は $-\text{CH}_2\text{COOR}^{11}$ で示される1価の基であり、 R^9 は、炭化水素基、シアノ基、 $-\text{[CH}(R^6)-\text{CH}(R^7)-\text{O}]_x-\text{R}^8$ 、 $-\text{[(CH}_2)_y-\text{O}]_z-\text{R}^8$ 、又は $-\text{[CO}-(\text{CH}_2)_y-\text{O}]_z-\text{R}^8$ で示される1価の基である。 R^{10} は、炭素数1～18のアルキル基であり、 R^{11} は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基を示す。

上記炭化水素基は、置換基を有していてもよい。

m は1～5の整数、 n 及び n' は5～200の整数を示す。 x は1～18の整数、 y は1～5の整数、 z は1～18の整数を示す。)

[0028] [化10]



(一般式 (V) 及び一般式 (V I) 中、 R^a 及び $R^{a'}$ はそれぞれ独立に、水素原子、水酸基、炭化水素基、 $-\text{[CH}(R^c)-\text{CH}(R^d)-\text{O}]_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2)_t-\text{O}]_u-\text{R}^e$ 、又は $-\text{O}-\text{R}^{a''}$ で示される1価の基である。 $R^{a''}$ は、炭化水素基、 $-\text{[CH}(R^c)-\text{CH}(R^d)-\text{O}]_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2)_t-\text{O}]_u-\text{R}^e$ 、又は $-\text{O}-\text{R}^{a''}$ で示される1価の基である。

$[(CH_2)_t-O]_u-R^e$ 、 $-C(R^f)(R^g)-C(R^h)(R^i)-OH$ 、又は、 $-CH_2-C(R^j)(R^k)-CH_2-OH$ で示される1価の基である。

R^b は、炭化水素基、 $-[CH(R^c)-CH(R^d)-O]_s-R^e$ 、 $-[(CH_2)_t-O]_u-R^e$ 、又は $-O-R^{b'}$ で示される1価の基である。 $R^{b'}$ は、炭化水素基、 $-[CH(R^c)-CH(R^d)-O]_s-R^e$ 、又は $-[(CH_2)_t-O]_u-R^e$ で示される1価の基である。

R^c 及び R^d は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基であり、 R^e は、水素原子、炭化水素基、 $-CHO$ 、 $-CH_2CHO$ 、又は $-CH_2COOR^l$ で示される1価の基であり、 R^l は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基である。

R^f 、 R^g 、 R^h 、 R^i 、 R^j 及び R^k は、それぞれ独立に、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基であって、 R^f 及び R^h は、互いに結合して環構造を形成してもよい。上記環状構造を形成した場合、置換基 R^n を有していてもよく、 R^n は、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基である。

R^a 、 $R^{a'}$ 、及び R^b において、炭化水素基はそれぞれ、置換基を有していてもよい。

s は1～18の整数、 t は1～5の整数、 u は1～18の整数を示す。）

[0029] 本発明に係る金属粒子分散体は、上記特定の金属粒子と、上記特定の分散剤とを組み合わせる用いることにより、分散性、分散安定性に優れ、金属粒子の沈降が抑制されたものである。また、本発明の金属粒子分散体は、低粘度の分散体とすることが可能である。

[0030] 上記特定の組み合わせにより、上記のような特定の効果を発揮する作用としては、未解明の部分もあるが、以下のように推定される。

従来、金属粒子分散体は、金属粒子の比重が、分散体中の各成分と比較して大きいことから、保存時に金属粒子が沈降するという問題があった。

本発明の金属粒子分散体は、分散剤として、一般式(1)で表される構成

単位と、一般式（ⅠⅠ）で表される構成単位とを有し、前記一般式（Ⅰ）で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、特定の酸性リン化合物、及び特定のスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも１種とが塩を形成したグラフト共重合体を用いて金属粒子を分散することにより、溶剤に対して不溶性となる分散剤中の塩形成部位が、金属粒子表面に強く吸着することで安定化するものと推定される。また、分散剤が有する一般式（ⅠⅠ）で表される構成単位は、ポリマー鎖を有するため溶剤への溶解性に優れている。このため、上記特定の分散剤が、金属粒子を取り囲んで、溶剤中で安定して存在するため、金属粒子同士の凝集が生じにくく、分散性及び分散安定性に優れ、金属粒子が沈降することをも抑制することができるものと推測される。

本発明に係る金属粒子分散体は、上述のように金属粒子の分散性及び分散安定性に優れているため、従来と比較して、金属粒子に対する分散剤の含有割合を低く抑えることも可能となる。そのため、低粘度の金属微粒子分散体とすることもでき、また、当該金属粒子分散体を、焼成して金属膜を形成する場合、焼結後の有機成分の残存が少ないというメリットがある。

なお、本発明において低粘度の具体的な目安としては、金属粒子分散体の粘度が $10\text{ mPa}\cdot\text{s}$ 以下のことをいい、更に、 $3\text{ mPa}\cdot\text{s}$ 以下であることが好ましい。このような低粘度の金属微粒子分散体は、インクジェット用の組成物としても好適に用いることができる。

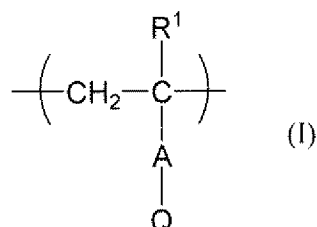
[0031] また、本発明に係る焼結膜形成用金属粒子分散体は、金属粒子と、分散剤と、溶剤とを含有し、

前記金属粒子は、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、亜鉛、及びゲルマニウムよりなる群から選択される１種以上を含む金属粒子であり、且つ、

前記分散剤は、下記一般式（Ⅰ）で表される構成単位と、下記一般式（ⅠⅠ）で表される構成単位とを有し、前記一般式（Ⅰ）で表される構成単位に

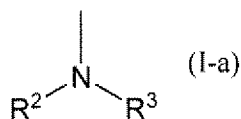
含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、前記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び前記一般式（V I）で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも１種とが塩を形成したグラフト共重合体である。

[化11]



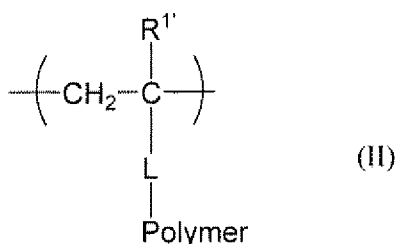
（一般式（I）中、Aは、直接結合又は２価の連結基、R¹は、水素原子又はメチル基、Qは、下記一般式（I-a）で表される基、又は、置換基を有していても良い、塩形成可能な含窒素複素環基を表す。）

[0032] [化12]



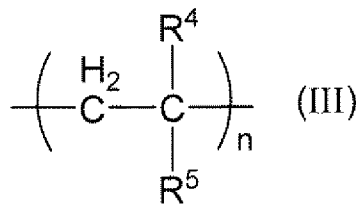
（一般式（I-a）中、R²及びR³は、それぞれ独立して、水素原子又はヘテロ原子を含んでもよい炭化水素基を表し、R²及びR³は互いに同一であっても異なってもよい。）

[0033] [化13]



（一般式（II）中、R^{1'}は、水素原子又はメチル基、Lは、直接結合又は２価の連結基、Polymerは、下記一般式（III）で表される構成単位を少なくとも１種有するポリマー鎖を表す。）

[0034] [化14]



(一般式 (III) 中、 R^4 は水素原子又はメチル基であり、 R^5 は炭素数3～18の分岐アルキル基、又は $-\text{CO}-\text{O}-\text{R}^9$ で示される1価の基である。 R^9 は、炭素数3～18の分岐アルキル基である。 n は5～200の整数を示す。)

[0035] 本発明の金属粒子分散体は、少なくとも金属粒子と、分散剤と、溶剤とを含有するものであり、本発明の効果が損なわれない限り、必要に応じて他の成分を含有してもよいものである。

以下、このような本発明の金属粒子分散体の各成分について順に詳細に説明する。

[0036] <金属粒子>

本発明に用いられる金属粒子は、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、及びゲルマニウムよりなる群から選択される1種以上を含む金属粒子である。なお、本発明において、金属粒子とは、金属状態の粒子に加えて、合金状態の粒子や、金属化合物の粒子等も含まれるものである。また、例えば、金属状態の粒子の表面が酸化されて金属酸化物となっているように、1つの粒子中に、金属、合金、及び金属化合物の1種以上が含まれていてもよいものである。代表的には、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、及びゲルマニウムよりなる群から選択される1種以上の金属、合金、及び金属化合物の1種以上である金属粒子が挙げられる。

また、焼結膜形成用途において、本発明に用いられる金属粒子は、金、銀

、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、亜鉛及びゲルマニウムよりなる群から選択される１種以上を含む金属粒子である。

金属の種類は、用途に応じて、導電性、抗菌性、熱線遮蔽性等を有するもの等を適宜選択することができる。なお、本発明の金属粒子分散体を焼成などにより金属膜とする場合には、当該金属膜が導電性、抗菌性、熱線遮蔽性等を発現する金属、合金、及び金属化合物の１種以上を適宜選択すればよい。

導電性を有する金属としては、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、インジウム、ガリウム、及びゲルマニウムが挙げられるが、これらのうち、金、銀、銅、及びニッケル等が導電性の点から好適なものとして挙げられる。抗菌性を有する金属としては、銀、及び銅が挙げられる。また、熱線遮蔽性が良好な金属としては、銀、銅、ITO（スズドープ酸化インジウム）、ATO（アンチモンドープ酸化スズ）、六ホウ化ランタンが挙げられる。なお、ここでの熱線遮蔽性には、熱線吸収性と熱線反射性が包含される。

[0037] 上記金属化合物としては、例えば、金属酸化物、金属水酸化物、金属硫化物、金属セレン化物、金属テルル化物、金属窒化物、金属リン化物、金属ホウ化物、金属ケイ化物、金属炭化物、金属塩化物等が挙げられる。焼成により金属膜とする場合には、焼成時に分解されて、金属となるものが好ましい。銀を有する金属化合物としては、例えば、酸化銀等が挙げられる。また、銅を有する金属化合物としては、例えば、酸化第一銅、酸化第二銅、及びこれらの混合物などの銅酸化物等が挙げられる。

また、合金としては、例えば、銅－ニッケル合金、銀－パラジウム合金等が挙げられる。

[0038] また、銅を有する金属化合物としては、下記(i)と(ii)と(iii)とを含む金属化合物が焼結膜形成用途に好適に用いられる。

(i) 銅、

(ii) インジウム、ガリウム、亜鉛、スズ、及びアルミニウムよりなる群から選択される1種以上、

(iii) 硫黄、セレン、及びテルルよりなる群から選択される1種以上

上記(i)と(ii)と(iii)とを含む金属化合物としては、具体的には、 CIS ($Cu-In-Se$) 系化合物あるいは $CIGS$ ($Cu-In-Ga-Se$) 系化合物、 $CZTS$ ($Cu-Zn-Sn-Se$) 系化合物、 $CuSbSe$ 等が挙げられる。より具体的には、 $CuAlS_2$, $CuGaS_2$, $CuInS_2$, $CuAlSe_2$, $CuGaSe_2$, $CuInSe_2$ (CIS), $Cu(In_{1-x}Ga_x)Se_2$ ($CIGS$), $Cu(In_{1-x}Al_x)Se_2$, $Cu(In_{1-x}Ga_x)(S, Se)_2$, $CuSbS_2$, Cu_2SbS_3 , Cu_2SnSe_3 , $CuZnSnS_2$, $Cu(In_{1-x}Ga_x)Te_2$ が挙げられ、 $CuInS_2$, $CuInSe_2$ (CIS), $Cu(In, Ga)S_2$, $Cu(In, Ga)Se_2$ ($CIGS$), $Cu_2ZnSn(S, Se)_2$ が特に好ましい。当該金属化合物を含有する金属粒子の焼結膜は、例えば光電変換半導体膜として好適に用いられる。

[0039] 金属粒子は、上記金属、合金、及び金属化合物の1種以上を含む金属粒子のうち、1種単独で、又は2種以上組み合わせて用いることができる。

例えば焼結膜形成用途において、例えば、銅粒子と、インジウム、ガリウム、亜鉛、スズ、及びアルミニウムよりなる群から選択される1種以上と、硫黄、セレン、及びテルルよりなる群から選択される1種以上とを含む金属化合物粒子の1種以上とを組み合わせる混合した分散体としたり、銅、インジウム、ガリウム、亜鉛、スズ、及びアルミニウムよりなる群から選択される1種以上と、硫黄、セレン、及びテルルよりなる群から選択される1種以上とを含む金属化合物粒子の2種以上を組み合わせる混合した分散体としても良い。

[0040] 上記金属粒子の調製方法は、従来公知の方法から適宜選択すればよい。例えば、メカノケミカル法などにより金属粉を粉砕する物理的な方法；化学気相法 (CVD法) や蒸着法、スパッタ法、熱プラズマ法、レーザー法のような

な化学的な乾式法；熱分解法、化学還元法、電気分解法、超音波法、レーザーアブレーション法、超臨界流体法、マイクロ波合成法等による化学的な湿式法等を用いて金属粒子を得ることができる。

[0041] 例えば、蒸着法では、高真空下で分散剤を含む低蒸気圧液体中に加熱蒸発した金属の上記を接触させて微粒子を製造する。

また、化学還元法の1種としては、錯化剤及び保護コロイドの存在下で、金属酸化物と還元剤とを溶媒中で混合して生成する方法が挙げられる。

[0042] 上記錯化剤とは、当該錯化剤が有する配位子のドナー原子と、金属イオン又は金属原子とが結合して、金属錯体化合物を形成するものである。上記ドナー原子としては、窒素原子、酸素原子、硫黄原子が好適に挙げられる。窒素原子がドナー原子である錯化剤としては、例えば、アミン類、イミダゾール及びピリジン等の窒素含有複素環式化合物類等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

また、上記保護コロイドは、精製した金属粒子の分散安定化剤として作用するものであり、具体的には、ゼラチン、アラビアゴム、カゼイン等のタンパク質系；デンプン、デキストリン等の天然高分子；ヒドロキシエチルセルロース等のセルロース系；ポリビニルアルコール等の親水性合成高分子等が挙げられる。中でも、分散安定性の点からは、タンパク質系の保護コロイドが好ましい。

なお、上記の方法の他、市販の金属粒子を適宜用いることができる。

[0043] 金属粒子の平均一次粒径は、用途に応じて適宜設定すればよいものであるが、通常、1～500nmの範囲で設定される。中でも、低粘度で分散性、分散安定性に優れ、沈降物を生じにくい点から、金属粒子の平均一次粒径が5～200nmであることが好ましい。

なお、上記金属粒子の平均粒径は、電子顕微鏡写真から一次粒子の大きさを直接計測する方法で求めることができる。具体的には、個々の一次粒子の短軸径と長軸径を計測し、その平均をその粒子の粒径とした。次に100個以上の粒子についてそれぞれ粒子の体積（質量）を、求めた粒径の直方体と

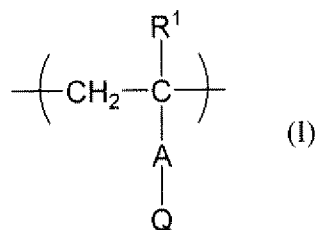
近似して求め、体積平均粒径として求めそれを平均粒径とした。なお、電子顕微鏡は透過型（TEM）、走査型（SEM）又は走査透過型（STEM）のいずれを用いても同じ結果を得ることができる。

[0044] 本発明の金属粒子分散体において、金属粒子の含有量は、用途に応じて適宜選択されれば良いが、分散性の点から、金属粒子分散体の全量に対して、1～70質量%であることが好ましく、更に、5～50質量%の範囲内であることがより好ましい。本発明においては、後述する分散剤と組み合わせて用いることにより、従来に比べて金属粒子の含有量を高めた場合であっても、金属粒子の分散性や分散安定性に優れ、沈降物を生じにくいものとすることができる。

[0045] <分散剤>

本発明において用いられる分散剤は、下記一般式（I）で表される構成単位と、下記一般式（II）で表される構成単位とを有し、前記一般式（I）で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、下記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び下記一般式（VI）で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも1種とが塩を形成したグラフト共重合体である。

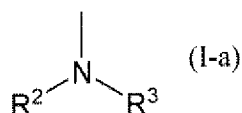
[0046] [化15]



（一般式（I）中、Aは、直接結合又は2価の連結基、R¹は、水素原子又はメチル基、Qは、下記一般式（I-a）で表される基、又は、置換基を有していても良い、塩形成可能な含窒素複素環基を表す。）

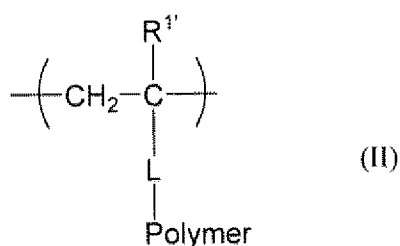
[0047]

[化16]



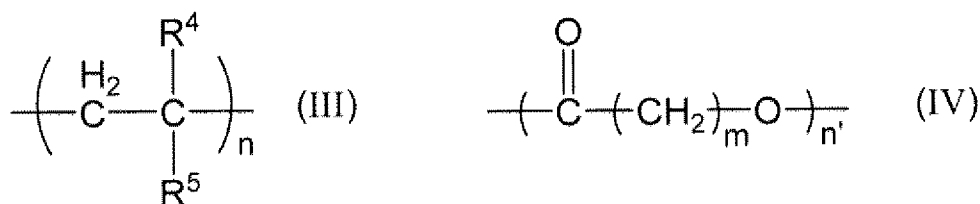
(一般式 (I-a) 中、 R^2 及び R^3 は、それぞれ独立して、水素原子又はヘテロ原子を含んでもよい炭化水素基を表し、 R^2 及び R^3 は互いに同一であっても異なってもよい。)

[0048] [化17]



(一般式 (II) 中、 $\text{R}^{1'}$ は、水素原子又はメチル基、 L は、直接結合又は2価の連結基、 Polymer は、下記一般式 (III) 又は一般式 (IV) で表される構成単位を少なくとも1種有するポリマー鎖を表す。)

[0049] [化18]



(一般式 (III) 及び、一般式 (IV) 中、 R^4 は水素原子又はメチル基であり、 R^5 は炭化水素基、シアノ基、 $-\text{CH}(\text{R}^6) - \text{CH}(\text{R}^7) - \text{O}$ 、 $-\text{R}^8$ 、 $-(\text{CH}_2)_y - \text{O}$ 、 $-\text{CO} - (\text{CH}_2)_y - \text{O}$ 、 $-\text{CO} - \text{O} - \text{R}^9$ 又は $-\text{O} - \text{CO} - \text{R}^{10}$ で示される1価の基である。 R^6 及び R^7 は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基である。

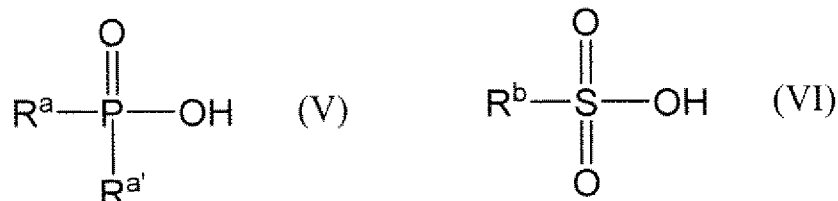
R^8 は、水素原子、炭化水素基、 $-\text{CHO}$ 、 $-\text{CH}_2\text{CHO}$ 又は $-\text{CH}_2\text{COOR}^{11}$ で示される1価の基であり、 R^9 は、炭化水素基、シアノ基、 $-\text{CH}$

$(R^6) - CH(R^7) - O]_x - R^8$ 、 $-[(CH_2)_y - O]_z - R^8$ 、又は $-[CO - (CH_2)_y - O]_z - R^8$ で示される1価の基である。 R^{10} は、炭素数1～18のアルキル基であり、 R^{11} は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基を示す。

上記炭化水素基は、置換基を有していてもよい。

m は1～5の整数、 n 及び n' は5～200の整数を示す。 x は1～18の整数、 y は1～5の整数、 z は1～18の整数を示す。)

[0050] [化19]



(一般式(V)及び一般式(VI)中、 R^a 及び $R^{a'}$ はそれぞれ独立に、水素原子、水酸基、炭化水素基、 $-[CH(R^c) - CH(R^d) - O]_s - R^e$ 、 $-[(CH_2)_t - O]_u - R^e$ 、又は $-O - R^{a''}$ で示される1価の基である。 $R^{a''}$ は、炭化水素基、 $-[CH(R^c) - CH(R^d) - O]_s - R^e$ 、 $-[(CH_2)_t - O]_u - R^e$ 、 $-C(R^f)(R^g) - C(R^h)(R^i) - OH$ 、又は、 $-CH_2 - C(R^j)(R^k) - CH_2 - OH$ で示される1価の基である。

R^b は、炭化水素基、 $-[CH(R^c) - CH(R^d) - O]_s - R^e$ 、 $-[(CH_2)_t - O]_u - R^e$ 、又は $-O - R^{b'}$ で示される1価の基である。 $R^{b'}$ は、炭化水素基、 $-[CH(R^c) - CH(R^d) - O]_s - R^e$ 、又は $-[(CH_2)_t - O]_u - R^e$ で示される1価の基である。

R^c 及び R^d は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基であり、 R^e は、水素原子、炭化水素基、 $-CHO$ 、 $-CH_2CHO$ 、又は $-CH_2COOR^l$ で示される1価の基であり、 R^l は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基である。

R^f 、 R^g 、 R^h 、 R^i 、 R^j 及び R^k は、それぞれ独立に、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで

結合した基であって、 R^f 及び R^h は、互いに結合して環構造を形成してもよい。上記環状構造を形成した場合、置換基 R^n を有していてもよく、 R^n は、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基である。

R^a 、 $R^{a'}$ 、及び R^b において、炭化水素基はそれぞれ、置換基を有していてもよい。

s は1～18の整数、 t は1～5の整数、 u は1～18の整数を示す。）

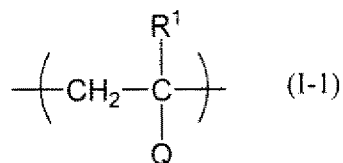
[0051] 本発明においては、分散剤として、ハロゲン化炭化水素、特定の酸性リン化合物、及び特定のスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも1種と塩を形成した窒素部位を有する上記一般式(1)で表される構成単位を含む特定のグラフト共重合体を用いることにより、前記金属粒子の分散性及び分散安定性が向上する。また、本発明の金属粒子分散体を焼成して金属膜を形成する場合には、焼成時の加熱により上記分散剤が分解されやすく、得られた金属膜は分散剤の残存が少ないため、導電性など、所望の機能を発現しやすい。また、上記分散剤を用いることにより金属微粒子分散体の低粘度化が可能となるため、本発明の金属粒子分散体は、インクジェット用のインクとしても好適に用いることができる。

[0052] (一般式(1)で表される構成単位)

本発明で用いられるグラフト共重合体は、一般式(1)で表される構成単位を有する。

一般式(1)において、 A は、直接結合又は2価の連結基である。直接結合とは、下記一般式(1-1)のように、 Q が連結基を介することなく炭素原子に直接結合していることを意味する。

[0053] [化20]



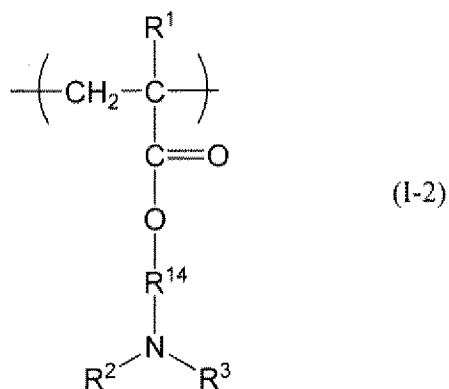
(一般式(1-1)中、 R^1 及び Q は、一般式(1)と同様である。)

[0054] Aにおける2価の連結基としては、例えば、炭素数1～10のアルキレン基、アリーレン基、 $-\text{CONH}-$ 基、 $-\text{COO}-$ 基、炭素数1～10のエーテル基($-\text{R}'-\text{OR}''-$; R' 及び R'' は、各々独立にアルキレン基)及びこれらの組み合わせ等が挙げられる。

中でも、分散性の点から、一般式(1)におけるAは、直接結合、或いは、 $-\text{CONH}-$ 基又は $-\text{COO}-$ 基を含む2価の連結基であることが好ましい。

例えば、Aが $-\text{COO}-$ 基を含む2価の連結基でQが上記一般式(1-a)で表される基である場合、一般式(1)で表される構成単位は下記式(1-2)で表される構造が挙げられる。

[0055] [化21]



(一般式(1-2)中、 R^1 は、一般式(1)と同様であり、 R^2 及び R^3 は、一般式(1-a)と同様であり、 R^{14} は、炭素数1～8のアルキレン基、 $-\text{CH}(\text{R}^{15})-\text{CH}(\text{R}^{16})-\text{O}]_x-\text{CH}(\text{R}^{15})-\text{CH}(\text{R}^{16})-$ 又は $-(\text{CH}_2)_y-\text{O}]_z-(\text{CH}_2)_y-$ であり、 R^{15} 及び R^{16} は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基である。 x は1～18の整数、 y は1～5の整数、 z は1～18の整数を表す。)

[0056] 一般式(1-2)中の R^{14} における炭素数1～8のアルキレン基は、直鎖状、分岐状のいずれであってもよく、例えば、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、プロピレン基、各種ブチレン基、各種ペンチレン基、各種ヘキシレン基、各種オクチレン基などである。

一般式 (1-2) 中の R^{15} 及び R^{16} は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基である。

x は 1 ～ 18 の整数、好ましくは 1 ～ 4 の整数、より好ましくは 1 ～ 2 の整数であり、 y は 1 ～ 5 の整数、好ましくは 1 ～ 4 の整数、より好ましくは 2 又は 3 である。 z は 1 ～ 18 の整数、好ましくは 1 ～ 4 の整数、より好ましくは 1 ～ 2 の整数である。

一般式 (1-2) 中の R^{14} としては、分散性の点から、炭素数 1 ～ 8 のアルキレン基が好ましく、中でも、 R^{14} がメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基であることが更に好ましく、メチレン基及びエチレン基がより好ましい。

[0057] 一般式 (1-a) における、 R^2 及び R^3 の、ヘテロ原子を含んでもよい炭化水素基における炭化水素基は、例えば、アルキル基、アラルキル基、アリール基などが挙げられる。

アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、*tert*-ブチル基、2-エチルヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられ、アルキル基の炭素数は、1 ～ 18 が好ましく、中でも、メチル基又はエチル基であることがより好ましい。

アラルキル基としては、例えば、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、ビフェニルメチル基等が挙げられる。アラルキル基の炭素数は、7 ～ 20 が好ましく、更に 7 ～ 14 が好ましい。

また、アリール基としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、トリル基、キシリル基等が挙げられる。アリール基の炭素数は、6 ～ 24 が好ましく、更に 6 ～ 12 が好ましい。なお、上記好ましい炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

ヘテロ原子を含む炭化水素基とは、上記炭化水素基中の炭素原子がヘテロ原子でおきかえられた構造を有する。炭化水素基が含んでもよいヘテロ原子としては、例えば、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ケイ素原子等が挙

げられる。

また、炭化水素基中の水素原子は、炭素数 1～5 のアルキル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子により置換されていてもよい。

[0058] また、Q における置換基を有していても良い、塩形成可能な含窒素複素環基としては、例えば、5～7 員環の含窒素複素環単環、又はこれらの縮合環が挙げられ、更に別のヘテロ原子を有していてもよく、置換基を有していてもよい。また、含窒素複素環基は芳香族性を有していてもよい。

上記含窒素複素環基を形成する含窒素複素環式化合物としては、具体的には、ピリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリン、ピロリジン、ピロリン、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾール、テトラゾール、ベンゾイミダゾール等が挙げられる。中でも、ピリジン、ピペリジン、ピペラジン、イミダゾール等のヘテロ原子として窒素原子のみを含む含窒素複素環式化合物であることが好ましく、ピリジン、イミダゾール等の芳香族性を有する含窒素複素環基であることがより好ましい。

[0059] 上記含窒素複素環基において、有していてもよい置換基としては、例えば炭素数 1～12 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アラルキル基、アリール基、F、Cl、Br などのハロゲン原子等が挙げられ、これらを組み合わせて用いることもできる。また、これらの置換基の置換位置、及び置換基数は特に限定されない。

[0060] 上記一般式 (I) で表される構成単位としては、ジメチルアミノエチル (メタ) アクリレート、ジメチルアミノプロピル (メタ) アクリレート、ジエチルアミノエチル (メタ) アクリレート、ジエチルアミノプロピル (メタ) アクリレート、ペンタメチルピペリジル (メタ) アクリレート等の含窒素 (メタ) アクリレート；ビニルイミダゾール、ビニルピリジン等の含窒素ビニル単量体；ジメチルアミノプロピルアクリルアミド等のアクリルアミド系単量体等から誘導される構成単位が挙げられるが、これらに限定されない。

一般式 (I) で表される構成単位は、前記金属粒子との親和性を有する部位として機能すれば良く、1 種からなるものであっても良いし、2 種以上の

構成単位を含んでもよい。

[0061] (一般式 (I I) で表される構成単位)

上記グラフト共重合体は、側鎖にポリマー鎖を含む前記一般式 (I I) で表される構成単位を有することにより、溶剤親和性が良好になり、金属粒子の分散性及び分散安定性が良好なものとなる。

[0062] 前記一般式 (I I) において、L は、直接結合又は 2 価の連結基である。

L における 2 価の連結基としては、エチレン性不飽和二重結合とポリマー鎖を連結可能であれば、特に制限はない。L における 2 価の連結基としては、例えば、アルキレン基、水酸基を有するアルキレン基、アリーレン基、 $-CONH-$ 基、 $-COO-$ 基、 $-NHCOO-$ 基、エーテル基 ($-O-$ 基)、チオエーテル基 ($-S-$ 基)、及びこれらの組み合わせ等が挙げられる。なお、本発明において、2 価の連結基の結合の向きは任意である。すなわち、2 価の連結基に $-CONH-$ が含まれる場合、 $-CO$ が主鎖の炭素原子側で $-NH$ が側鎖のポリマー鎖側であっても良いし、反対に、 $-NH$ が主鎖の炭素原子側で $-CO$ が側鎖のポリマー鎖側であっても良い。

[0063] 前記一般式 (I I) において、Polymer は、前記一般式 (I I I) 又は前記一般式 (I V) で表される構成単位を少なくとも 1 種有するポリマー鎖を表す。

式 (I I I) 中、 R^4 は水素原子又はメチル基であり、 R^5 は炭化水素基、シアノ基、 $-[CH(R^6)-CH(R^7)-O]_x-R^8$ 、 $-[(CH_2)_y-O]_z-R^8$ 、 $-[CO-(CH_2)_y-O]_z-R^8$ 、 $-CO-O-R^9$ 又は $-O-CO-R^{10}$ で示される 1 価の基である。

R^5 における炭化水素基としては、炭素数 1 ~ 18 のアルキル基、炭素数 2 ~ 18 のアルケニル基、アラルキル基、又はアリール基であることが好ましい。

上記炭素数 1 ~ 18 のアルキル基は、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよく、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、2-エチルヘキシル基、2-エトキシエチル基、シクロ

ペンチル基、シクロヘキシル基、ボルニル基、イソボルニル基、ジシクロペンタニル基、アダマンチル基、低級アルキル基置換アダマンチル基などを挙げることができる。

上記炭素数2～18のアルケニル基は、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。このようなアルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、プロペニル基などを挙げることができる。アルケニル基の二重結合の位置には限定はないが、得られたポリマーの反応性の点からは、アルケニル基の末端に二重結合があることが好ましい。

[0064] R^5 における、アリール基としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、トリル基、キシリル基等が挙げられる。アリール基の炭素数は、6～24が好ましく、更に6～12が好ましい。

R^5 における、アラルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、ビフェニルメチル基等が挙げられる。アラルキル基の炭素数は、7～20が好ましく、更に7～14が好ましい。

[0065] R^8 は、水素原子、あるいは炭素数1～18のアルキル基、アラルキル基、アリール基、 $-CHO$ 、 $-CH_2CHO$ 又は $-CH_2COOR^{11}$ で示される1価の基であり、 R^9 は、炭素数1～18のアルキル基、アラルキル基、アリール基、シアノ基、 $-[CH(R^6)-CH(R^7)-O]_x-R^8$ 、 $-[(CH_2)_y-O]_z-R^8$ 、又は $-[CO-(CH_2)_y-O]_z-R^8$ で示される1価の基である。 R^{10} は、炭素数1～18のアルキル基であり、 R^{11} は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基を示す。

上記 R^8 、及び R^9 のうちの炭素数1～18のアルキル基、アラルキル基、アリール基は、前記の R^5 で示したとおりである。

上記 R^{10} 、及び R^{11} のうちのアルキル基は、前記の R^5 で示したとおりである。

上記 R^5 、 R^8 、 R^9 、及び R^{10} が、芳香環を有する基である場合、当該芳香環はさらに置換基を有していてもよい。当該置換基としては、例えば炭素数1～5の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基の他、アルケニル基、ニトロ基

、F、Cl、Br等のハロゲン原子などが挙げられる。

なお、上記好ましい炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

上記R⁵及びR⁹において、x、y及びzは、前記Aで説明したとおりである。

[0066] さらに、上記R⁵、R⁸、R⁹、及びR¹⁰は、上記グラフト共重合体の分散性能等を妨げない範囲で、更に、アルコキシ基、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基、イソシアネート基、水素結合形成基等の置換基によって置換されたものとしてもよい。また、これらの置換基を有するグラフト共重合体を合成した後に、当該置換基と反応する官能基と重合性基とを有する化合物を反応させて、重合性基を付加したものとしてもよい。例えば、カルボキシル基を有するグラフト共重合体にグリシジル（メタ）アクリレートを反応させたり、イソシアネート基を有するグラフト共重合体にヒドロキシエチル（メタ）アクリレートを反応させたりして、重合性基を付加することができる。

[0067] 一般式（I I）で表される構成単位に含まれるポリマー鎖は、上記した構成単位のなかでもメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、n-ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、tert-ブチル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、2-エトキシエチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、アダマンチル（メタ）アクリレート、スチレン、 α -メチルスチレン、ビニルシクロヘキサンなど由来の構成単位を有するものが好ましい。しかしながら、これらに限定されるものではない。

[0068] 一般式（I V）において、mは1～5の整数であり、好ましくは2～5の整数、より好ましくは4又は5の整数である。また、ポリマー鎖の構成単位のユニット数n及びn'は、5～200の整数であればよく、特に限定され

ないが、5～100の範囲内であることが好ましい。

[0069] 本発明において、上記R⁵及びR⁹としては、中でも、後述する溶剤との溶解性に優れたものを用いることが好ましく、金属粒子分散体に使用する溶剤に合わせて適宜選択されれば良い。具体的には、例えば上記溶剤が、金属粒子分散体の溶剤として一般的に使用されているエーテルアルコールアセート系、エーテル系、エステル系などの溶媒を用いる場合には、メチル基、エチル基、イソブチル基、n-ブチル基、2-エチルヘキシル基、ベンジル基等が好ましい。

ここで、上記R⁵及びR⁹をこのように設定する理由は、上記R⁵及びR⁹を含む構成単位が、上記溶媒に対して溶解性を有し、上記モノマーの塩基部分が形成する塩形成部位が金属粒子に対して高い吸着性を有するものであることにより、金属粒子の分散性、及び安定性を特に優れたものとすることができるからである。

更に、上記R⁵及びR⁹としては、金属粒子分散体の用途に合わせて適宜選択されることが好ましい。例えば、金属粒子分散体を焼成して用いる場合には、上記R⁵及びR⁹としては、熱分解し易い、分岐アルキル基（イソプロピル、イソブチル、2-エチルヘキシル）やメチル基、n-ブチル基などが好ましい。金属粒子分散体を焼成して用いる場合には、当該分岐アルキル基としては、炭素数3～18の分岐アルキル基であることが好ましく、更に炭素数3～8の分岐アルキル基であることがさらに好ましい。

また、例えば、熱線遮蔽性等を有する機能性フィルムに用いる場合には、上記R⁵及びR⁹としては、透明性や耐熱性を考慮して、脂環アルキル基（シクロヘキシル、イソボルニル、アダマンチル）などが好ましい。

更に、金属粒子分散体を含む樹脂成型品とする場合には、組み合わせて使用する樹脂と類似の骨格とすることが好ましく、例えば、ポリメチルメタクリレートを用いる場合には、上記R⁵及びR⁹としてはメチル基等とすることが好ましい。

[0070] Polymerにおけるポリマー鎖の質量平均分子量Mwは、500～1

5000の範囲内であることが好ましく、1000～8000の範囲内であることがより好ましい。上記範囲であることにより、分散剤としての十分な立体反発効果を保持できるとともに、立体効果による金属粒子の分散に要する時間の増大を抑制することもできる。

[0071] また、P o l y m e rにおけるポリマー鎖は、目安として、組み合わせて用いられる溶剤に対して、23℃における溶解度が50（g／100g溶剤）以上であることが好ましい。

当該ポリマー鎖の溶解性は、グラフト共重合体を調製する際のポリマー鎖を導入する原料が上記溶解度を有することを目安にすることができる。例えば、グラフト共重合体にポリマー鎖を導入するために、ポリマー鎖及びその末端にエチレン性不飽和二重結合を有する基を含む重合性オリゴマーを用いた場合、当該重合性オリゴマーが上記溶解度を有すれば良い。また、エチレン性不飽和二重結合を有する基を含むモノマーにより共重合体が形成された後に、共重合体中に含まれる反応性基と反応可能な反応性基を含むポリマー鎖を用いて、ポリマー鎖を導入する場合、当該反応性基を含むポリマー鎖が上記溶解度を有すれば良い。

[0072] 上記ポリマー鎖は、単独重合体でもよく、共重合体であってもよい。また、一般式（I）で表される構成単位に含まれるポリマー鎖は、グラフト共重合体において、1種単独でも良いが、2種以上混合していても良い。

[0073] 上記グラフト共重合体において、前記一般式（I）で表される窒素部位を含む構成単位は、3～80質量%の割合で含まれていることが好ましく、5～50質量%がより好ましく、10～40質量%がさらに好ましい。グラフト共重合体中の窒素部位を含む構成単位の含有量が上記範囲内にあれば、グラフト共重合体中の塩形成部位による金属粒子に対する吸着性とグラフト共重合体中のポリマー鎖による溶剤に対する溶解性のバランスが適切となり、優れた分散性、及び分散安定性が得られる。

なお、上記構成単位の含有割合は、一般式（I）で表される構成単位を有するグラフト共重合体を合成する際の仕込み量から算出される。

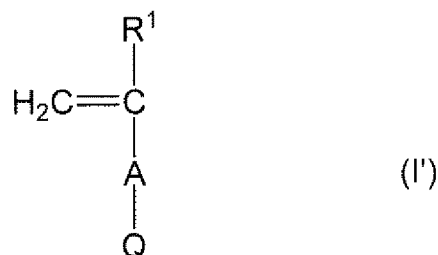
[0074] また、上記グラフト共重合体の重量平均分子量 M_w は、1000～100000の範囲内であることが好ましく、3000～30000の範囲内であることがより好ましく、5000～20000の範囲内であることがさらに好ましい。上記範囲であることにより、金属粒子を均一に分散させることができる。

[0075] なお、上記重量平均分子量 M_w は、GPC（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）により測定された値である。測定は、東ソー社製のHLC-8120GPCを用い、溶出溶媒を0.01モル／リットルの臭化リチウムを添加したN-メチルピロリドンとし、校正曲線用ポリスチレンスタンダードを M_w 377400、210500、96000、50400、20650、10850、5460、2930、1300、580（以上、Polymer Laboratories社製 Easi PS-2シリーズ）及び M_w 1090000（東ソー社製）とし、測定カラムをTSK-GEL ALPHA-M×2本（東ソー社製）として行われたものである。

[0076] 本発明において、グラフト共重合体の製造方法としては、前記一般式（I）で表される構成単位と、前記一般式（II）で表される構成単位とを有するグラフト共重合体を製造することができる方法であればよく特に限定されない。例えば、下記一般式（I'）で表される窒素含有モノマーと、前記一般式（III）又は前記一般式（IV）で表される構成単位を少なくとも1種有するポリマー鎖及びその末端にエチレン性不飽和二重結合を有する基からなる重合性オリゴマーとを共重合成分として含有して共重合し、グラフト共重合体を製造する方法が挙げられる。必要に応じて更にその他のモノマーも用い、公知の重合手段を用いてグラフト共重合体を製造することができる。

[0077]

[化22]



(一般式 (I') 中、 R^1 、 A 、 Q は、一般式 (I) と同様である。)

[0078] また、前記一般式 (I') で表される窒素含有モノマーとその他のエチレン性不飽和二重結合を有する基を含むモノマーとを付加重合して共重合体が形成された後に、共重合体中に含まれる反応性基と反応可能な反応性基を含むポリマー鎖を用いて、ポリマー鎖を導入しても良い。具体的には例えば、アルコキシ基、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基、イソシアネート基、水素結合形成基等の置換基を有する共重合体を合成した後に、当該置換基と反応する官能基を含むポリマー鎖とを反応させて、ポリマー鎖を導入したものであっても良い。

例えば、側鎖にカルボキシル基を有する共重合体に、末端にグリシジル基を有するポリマー鎖を反応させたり、側鎖にイソシアネート基を有する共重合体に、末端にヒドロキシ基を有するポリマー鎖を反応させたりして、ポリマー鎖を導入することができる。

なお、上記重合においては、重合に一般的に用いられる添加剤、例えば重合開始剤、分散安定剤、連鎖移動剤などを用いてもよい。

[0079] (ハロゲン化炭化水素、酸性リン化合物、スルホン酸化合物)

本発明の分散剤は、上記一般式 (I) で表される構成単位が有する窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、下記一般式 (V) で表される酸性リン化合物、及び下記一般式 (VI) で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも1種とが塩を形成したグラフト共重合体である。

本発明においては、ハロゲン化炭化水素、下記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び下記一般式（V I）で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも１種を塩形成剤として用いることにより、分散剤を、前記金属粒子の分散性及び安定性に優れ、本発明の金属粒子分散体を焼成して金属膜を形成する場合に焼成時に当該分散剤を揮散乃至分解しやすいものとすることができる。

[0080] 前記ハロゲン化炭化水素としては、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子のいずれかのハロゲン原子が、飽和又は不飽和の直鎖、分岐又は環状の炭化水素の水素原子と置換されているものが挙げられる。

また、上記ハロゲン化炭化水素の炭素数としては、１～３０であることが好ましく、更に１～２５、より更に１～１８であることが好ましい。

[0081] 上記ハロゲン化炭化水素のうち、ハロゲン化アルキルとしては、炭素数１～１８のものが挙げられるが特に限定されない。具体的には、例えば、塩化メチル、臭化メチル、塩化エチル、臭化エチル、ヨウ化メチル、ヨウ化エチル、塩化ｎ－ブチル、塩化ヘキシル、塩化オクチル、塩化ドデシル、塩化テトラデシル、塩化ヘキサデシル等が挙げられる。また、ハロゲン化アリルとしては、例えば、塩化アリル、臭化アリル、ヨウ化アリルが挙げられる。また、上記ハロゲン化アラルキルのアラルキル基としては、炭素数７～１８のものが挙げられるが特に限定されない。具体的には、例えば、塩化ベンジル、臭化ベンジル、ヨウ化ベンジル、塩化ナフチルメチル、塩化ピリジルメチル、臭化ナフチルメチル、臭化ピリジルメチル等が挙げられる。また、ハロゲン化アリールとしては、炭素数６～１８のものが挙げられるが特に限定されない。具体的には、例えば、塩化ベンゼン等が挙げられる。

[0082] 中でも、金属粒子の分散性を高める点から、ハロゲン化アリル及びハロゲン化アラルキルの少なくとも１つであることが好ましく、更にハロゲン化アリルであることが好ましい。

具体的には、塩化アリル、臭化アリル、ヨウ化アリル、塩化ベンジル、臭化ベンジル、及びヨウ化ベンジルからなる群から選択される少なくとも１種

であることが、塩形成反応のしやすさと、生成した塩形成部位が金属粒子への吸着性に優れている点から好ましい。

[0083] 本発明で用いられる前記酸性リン化合物は、前記一般式 (V) で表される化合物であり、前記スルホン酸化合物は、前記一般式 (V I) で表される化合物である。

前記一般式 (V) 及び一般式 (V I) において、 R^a 、 $R^{a'}$ 、 $R^{a''}$ 、 R^b 、 $R^{b'}$ 、及び R^e における、炭化水素基としては、炭素数 1～18 のアルキル基、炭素数 2～18 のアルケニル基、アラルキル基、又はアリール基であることが好ましく、当該炭素数 1～18 のアルキル基、アラルキル基、及びアリール基は、前記一般式 (I I I) における R^5 と同様のものとすることができる。

前記一般式 (V) 及び一般式 (V I) において、 R^f 、 R^g 、 R^h 、 R^i 、 R^j 、 R^k 、 R^l 、及び R^n における、炭化水素基としては、炭素数 1～18 のアルキル基、炭素数 2～18 のアルケニル基、アラルキル基、又はアリール基であることが好ましく、当該炭素数 1～18 のアルキル基、アラルキル基、及びアリール基も、前記一般式 (I I I) における R^5 と同様のものとすることができる。

中でも、炭素数が 1～8 のアルキル基、炭素数が 7～11 のアラルキル基、炭素数が 6～12 のアリール基が、金属粒子の分散性が良好な点、及び金属粒子分散体を焼成する際に有機成分が残存し難い点から好適に用いられる。

R^a 、 $R^{a'}$ 、 $R^{a''}$ 、 R^b 及び $R^{b'}$ において、 s は 1～18 の整数、 t は 1～5 の整数、 u は 1～18 の整数である。 s は、好ましくは 1～4 の整数、より好ましくは 1～2 の整数であり、 t は、好ましくは 1～4 の整数、より好ましくは 2 又は 3 である。 u は、好ましくは 1～4 の整数、より好ましくは 1～2 の整数である。

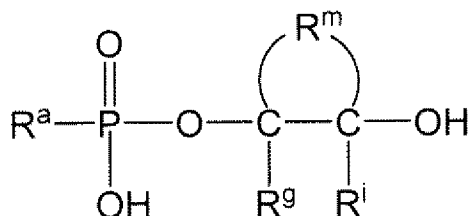
[0084] R^f 、 R^g 、 R^h 、 R^i 、 R^j 及び R^k 、並びに、 R^n における、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも 1 つで結合した基とは、 $-R'-$

$O-R''$ 、 $-R'-(C=O)-O-R''$ 、又は $-R'-O-(C=O)-R''$ (R' 及び R'' は、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基) で表される基である。1つの基の中に、エーテル結合及びエステル結合を2つ以上有していてもよい。なお上記炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合すると、少なくとも1つは2価の炭化水素基となるので、その場合、炭素数1～18のアルキル基、アラルキル基、及びアリール基は、それぞれ、アルキレン基、アリーレン基、及びこれらの組み合わせの2価の基になる。

[0085] また、一般式 (V) において、 R^f 及び R^h が、互いに結合して環構造を形成しているとは、具体的には、下記一般式 (V-1) で表される構造を有するものが挙げられる。

[0086] [化23]

一般式 (V-1)



(一般式 (V-1) 中、 R^a 、 R^g 、及び R^i は、上記一般式 (V) におけるものと同様である。 R^m は、上記 R^f 及び R^h が結合した基であって、更に置換基 R^n を有していてもよい。)

[0087] R^f と R^h が結合して環構造を形成する場合、環構造を形成する炭素原子数は、5～8であることが好ましく、6であること、即ち6員環であることがより好ましい。

[0088] $-C(R^f)(R^g)-C(R^h)(R^i)-OH$ 、又は、 $-CH_2-C(R^j)(R^k)-CH_2-OH$ はそれぞれ、例えば、リン酸基の酸性基 (OH) に単官能エポキシ化合物、又は単官能オキセタン化合物を反応させることにより、得ることができる。

[0089] 金属粒子分散体を焼成して金属膜を形成する用途に用いる場合には、金属

粒子の分散性に優れ、且つ、金属膜の抵抗値が低くなる点から、前記一般式（V）で表される酸性リン化合物は、 R^a 及び $R^{a'}$ の少なくとも1つが、水素原子及び水酸基の少なくとも1つであることが好ましい。

[0090] ハロゲン化炭化水素、下記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び下記一般式（V I）で表されるスルホン酸化合物は、1種単独で、又は2種以上組み合わせて用いることができる。

[0091] 本発明で用いる分散剤におけるハロゲン化炭化水素、下記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び下記一般式（V I）で表されるスルホン酸化合物の少なくとも1種の含有量は、良好な分散安定性が発揮されるのであればよく、特に制限はないが、一般に前記一般式（I）で表される構成単位に含まれる窒素部位に対して、0.05～2.0モル当量程度、好ましくは0.1～1.0モル当量、より好ましくは0.2～0.8モル当量とすることが、金属粒子の分散安定性を向上させる点から好ましい。

[0092] （分散剤の製造）

本発明において分散剤に用いられる塩型分散剤の製造方法としては、上記で得られたグラフト共重合体の前記一般式（I）で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、上記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び上記一般式（V I）で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも1種とが塩を形成したグラフト共重合体を製造することができる方法であればよく特に限定されない。

例えば、上記で得られたグラフト共重合体を、後述する溶剤中に溶解又は分散し、次いで該溶剤中に上記ハロゲン化炭化水素、前記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び前記一般式（V I）で表されるスルホン酸化合物の少なくとも1種を添加し、攪拌、更に必要により加熱することにより製造することができる。

[0093] 本発明の金属粒子分散体において、分散剤は、上記グラフト共重合体を1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよく、その含有量は、用いる金属粒子の種類等に応じて適宜設定されるが、金属粒子100

質量部に対して、通常、1～200質量部の範囲であり、3～100質量部であることが好ましく、5～80質量部であることがより好ましい。分散剤の含有量が上記範囲内にあれば、金属粒子を均一に分散させることができ、分散安定性に優れている。

[0094] <溶剤>

本発明の金属粒子分散体において、溶剤は、金属粒子分散体中の各成分とは反応せず、これらを溶解もしくは分散可能な有機溶剤であればよく、特に限定されない。具体的には、メチルアルコール、エチルアルコール、N-プロピルアルコール、イソプロピルアルコールなどのアルコール系；メトキシアルコール、エトキシアルコール、メトキシエトキシエタノール、エトキシエトキシエタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテルなどのエーテルアルコール系；酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸3-メトキシブチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、乳酸エチルなどのエステル系；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン系；メトキシエチルアセテート、メトキシプロピルアセテート、メトキシブチルアセテート、エトキシエチルアセテート、エチルセロソルブアセテート、メトキシエトキシエチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートなどのエーテルアルコールアセテート系；ジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系；N，N-ジメチルホルムアミド、N，N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンなどの非プロトン性アミド系； γ -ブチロラクトンなどのラクトン系；ベンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレンなどの不飽和炭化水素系；n-ヘプタン、n-ヘキサン、n-オクタンなどの飽和炭化水素系などの有機溶剤が挙げられる。

[0095] これらの中では、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロ

ヘキサノンなどのケトン系；プロピレングリコールモノメチルエーテルなどのエーテルアルコール系；メトキシエチルアセテート、エトキシエチルアセテート、エチルセロソルブアセテート、メトキシエトキシエチルアセテート、エトキシエトキシエチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなどのエーテルアルコールアセテート系；エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエーテルなどのエーテル系；酢酸3-メトキシブチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、乳酸エチルなどのエステル系等を好適に用いることができる。

中でも、本発明に用いられる溶剤としては、(MEK)メチルエチルケトン、MIBK(メチルイソブチルケトン)、MBA(酢酸3-メトキシブチル)、PGMEA(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)、DMDG(ジエチレングリコールジメチルエーテル)、BCA(ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート)、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、PGME(プロピレングリコールモノメチルエーテル)又はこれらを混合したものが、分散剤の溶解性や塗布適性の点から好ましい。

[0096] 本発明の金属粒子分散体における溶剤の含有量は、該金属粒子分散体の各構成を均一に溶解又は分散することができるものであればよく、特に限定されない。本発明においては、該金属粒子分散体中の固形分含有量が、5～70質量%の範囲が好ましく、10～50質量%の範囲がより好ましい。上記範囲であることにより、塗布に適した粘度とすることができる。

[0097] <その他の成分>

本発明の金属粒子分散体には、本発明の効果を損なわない範囲で、必要に応じて、その他の成分を含有してもよい。

その他の成分としては、例えば、錯化剤、保護コロイド、還元剤、濡れ性向上のための界面活性剤、密着性向上のためのシランカップリング剤、消泡

剤、ハジキ防止剤、酸化防止剤、凝集防止剤、紫外線吸収剤等が挙げられる。

[0098] ＜金属粒子分散体の製造方法＞

本発明において、金属粒子分散体の製造方法は、金属粒子が良好に分散できる方法であればよく、従来公知の方法から適宜選択して用いることができる。具体的には、例えば、前記分散剤を前記溶媒に混合、攪拌し、分散剤溶液を調製した後、当該分散剤溶液に、金属粒子と、必要に応じて他の成分を混合し、公知の攪拌機、又は分散機等を用いて分散させることによって、金属粒子分散体を調製することができる。

[0099] ＜金属粒子分散体の用途＞

本発明の金属粒子分散体は、分散性及び分散安定性に優れ、金属粒子の沈降も抑制されることから、従来公知の用途に好適に用いることができる。本発明の金属粒子分散体は、例えば、導電性材料、金属光沢を付与する材料、抗菌性材料、熱線遮蔽性を付与する材料、帯電防止性を付与する材料、蛍光材料等に用いられる。更に本発明の金属粒子分散体は、従来よりも低温で焼成した場合であっても、得られた金属膜に有機成分の残存が少ないことから、特に、焼成による金属膜形成用途に好適に用いることができる。

[0100] [物品]

本発明に係る物品は、前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜、成形体又は焼結膜を含むことを特徴とする。

[0101] 本発明に係る物品は、前記本発明に係る分散性が良好な金属粒子分散体を用いることにより、金属粒子の凝集や偏りが低減された均一な塗膜や成形体を有する高品質な物品を得ることができる。また、焼成により、前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の焼結膜とした場合には、有機成分の残存が少ない金属膜を含む高品質な物品を得ることができる。

[0102] 前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜を含む物品としては、典型的には、塗膜の支持体となる基材を含む態様が挙

げられる。一態様としては、基材上に少なくとも前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜を含む基板の態様をとる物品が挙げられる。なお、金属粒子分散体を含む組成物の塗膜には、組成物に光及び／又は熱硬化性樹脂が含まれる場合等、硬化塗膜も包含される。

また、前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の焼結膜を含む物品としても、典型的には、焼結膜の支持体となる基材を含む態様が挙げられる。

ここで、上記塗膜及び焼結膜としては、連続層だけでなく、島状の不連続層であっても良く、金属粒子が何らかの基材に不連続に担持されている状態を含む。

[0103] このような本発明に係る基板の態様をとる物品について、図を参照しながら説明する。

図1は、本発明の物品の一例を示す概略断面図であり、物品100は、基材1上に、金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物を焼成処理して形成された焼結膜2を有している。

図2は、本発明の物品の他の一例を示す概略断面図であり、物品100は、基材1上に、金属粒子4が薄膜3で担持された塗膜10を有している。

また、図3は、本発明の物品の他の一例を示す概略断面図であり、物品100は、基材1上に、マトリックス5中に金属粒子6を含有する塗膜10を有している。

[0104] 上記基材を含む態様に用いられる基材としては、従来公知の基材の中から、用途に応じて適宜選択すればよく、特に限定されない。例えば、樹脂基材やガラス基材が挙げられる。焼結膜の支持体となる基材としては、ガラス基材が好適に用いられるが、前記本発明に係る金属粒子分散体は、従来よりも低温で焼結が可能であるため、従来焼結膜に対しては適用が困難であった樹脂基材であっても好適に用いることができる。当該樹脂基材としては、中でも、耐熱性に優れた基材であること好ましく、具体的には、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂等が挙げられる。

当該基材の形状は、用途に応じて適宜選択すればよく、平板上であっても、曲面を有するものであってもよい。平板上の基材を用いる場合、当該基材の厚みは、用途に応じて適宜設定すればよく、例えば $25\ \mu\text{m} \sim 100\ \text{mm}$ 程度のものとすることができる。

[0105] 前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜を含む物品としては、例えば、熱線遮蔽フィルムや、帯電防止フィルム等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

また、前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の焼結膜、すなわち、金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜が焼成されてなる、焼結膜を含む物品としては、例えば、配線基板、導電膜、電極、光電変換半導体膜等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

これらの物品の上記塗膜又は焼結膜以外の構成については、従来公知の構成を適宜選択して用いることができる。

[0106] 一方、前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の成形体を含む物品としては、典型的には、支持体となる基材を含まない態様が挙げられる。

例えば、金属粒子分散体を、抗菌剤、色材、又は補強材等として含有した、樹脂成形物や、樹脂繊維などが挙げられ、抗菌性物品、意匠性物品等が挙げられる。

[0107] 金属粒子分散体を含む組成物に含まれる構成成分は、例えば、前記塗膜 10 において、薄膜 3、マトリックス 5、又は成形体のマトリックスとなり得るものであるが、これらは、各物品において公知の構成成分を適宜選択して採用すれば良い。

[0108] 金属粒子分散体を含む組成物に含まれる構成成分としては、例えば、アクリル（共）重合体が挙げられる。具体的には、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、*n*-プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、*n*-ブチル（メタ）アクリレート、*sec*

ーブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、*tert*-ブチル（メタ）アクリレート、*n*-ペンチル（メタ）アクリレート、*n*-ヘキシル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、スチレン、2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、及び（メタ）アクリル酸よりなる群から選択される1種以上のモノマーを重合した重合体又は共重合体が挙げられる。

焼結膜形成用途としては、イソプロピルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレートなどの分岐アルキル基を有するモノマーを重合成分に含んで重合したアクリル（共）重合体が好ましく、分散性の観点から、前記分岐アルキル基を有するモノマーとメタクリル酸などの酸価を有するモノマーとを重合成分に含んで重合したアクリル共重合体が更に好ましい。

これらは一例であり、金属粒子分散体を含む組成物に含まれる構成成分は、各物品において公知の構成成分を適宜選択して採用すれば良く、上記に限定されるものではない。

[0109] また、各物品において、前記本発明に係る金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜、成形体又は焼結膜以外の構成や構成成分についても、各物品において公知の構成や構成成分を適宜選択して採用すれば良い。

具体的には、例えば熱線遮蔽フィルムの場合、樹脂基材等の基材上に、前記本発明に係る金属粒子分散体と光硬化性樹脂を含む組成物の硬化膜が配置された構造が挙げられる。当該樹脂基材や当該光硬化性樹脂は、熱線遮蔽フィルムに従来用いられていた樹脂基材や光硬化性樹脂を適宜選択して用いることができる。

[0110] <物品の製造方法>

物品の製造方法は、例えば、基材又は基材上の他の機能層上に、上記金属粒子分散体又は上記金属粒子分散体を含む組成物を塗布して、塗膜を形成す

ることにより得ることができる。また、当該塗膜は、必要に応じて焼成処理して、焼結膜とすることができる。

本発明の焼結膜の製造方法は、焼結膜形成用金属粒子分散体を含む組成物（塗布液）を、基材上に塗布して塗膜を形成する工程と、当該塗膜を焼成処理する工程とを有する。

[0111] 金属粒子分散体又は上記金属粒子分散体を含む組成物を塗布する方法は、従来公知の方法を適宜選択すればよい。例えば、グラビア印刷、スクリーン印刷、スプレーコート、ダイコート、スピコート、コンマコート、バーコート、ナイフコート、オフセット印刷、フレキソ印刷、インクジェット印刷、ディスペンサ印刷等の方法が挙げられる。中でも、微細なパターンニングを行うことができる点から、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷、及びインクジェット印刷が好ましい。特に、本発明の金属粒子分散体は、分散性に優れているため、インクジェットの吐出ノズルにつまりが生じたり、吐出曲がりが生じることがないため、インクジェット印刷に適している。

[0112] 得られた塗膜は、従来公知の方法で乾燥してもよい。乾燥後の膜厚は、用途に応じて適宜調整すればよいものであるが、通常、 $0.01 \sim 100 \mu\text{m}$ の範囲であり、好ましくは、 $0.1 \sim 50 \mu\text{m}$ である。

[0113] 塗膜を焼成して焼結膜とする場合には、従来公知の焼成方法を用いればよい。例えば、金属粒子同士が焼成する温度に昇温する方法や、マイクロ波エネルギーの印加により発生する表面波プラズマによる方法等が挙げられる。

[0114] また、上記金属粒子分散体を含む組成物の成形体を製造する方法は、従来公知の方法を適宜選択すればよい。例えば、樹脂をマトリックスとする場合の成形方法としては、射出成形、ブロー成形、真空成形、圧空成形等を挙げることができる。

実施例

[0115] 以下、本発明について実施例を示して具体的に説明する。これらの記載により本発明を制限するものではない。

[0116] （合成例 1 銅粒子の製造）

酸化第二銅 64 g とゼラチン 5.1 g を 650 mL の純水に添加し、混合して混合液とした。15% のアンモニア水を用いて、当該混合液の pH を 10 に調整した後、20 分かけて室温から 90℃ まで昇温した。昇温後、攪拌しながら錯化剤として 1% のメルカプト酢酸溶液 6.4 g と、80% のヒドラジーン水和物 75 g を 150 mL の純水に混合した液を添加し、1 時間かけて酸化第二銅と反応させて、銅粒子を生成させた。その後、濾過洗浄し、乾燥することで、銅粒子を得た。得られた銅粒子を走査透過型電子顕微鏡 (STEM) で観察したところ、平均一次粒径は、50 nm であった。

[0117] (合成例 2 マクロモノマー MM-1 の合成)

冷却管、添加用ポート、窒素用インレット、機械的攪拌機、デジタル温度計を備えた反応器に、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (略称 PGMEA) 80.0 質量部を仕込み、窒素気流下攪拌しながら、温度 90℃ に加温した。メタクリル酸メチル 50.0 質量部、メタクリル酸-*n*-ブチル 15.0 質量部、メタクリル酸ベンジル 15.0 質量部、メタクリル酸 2-エトキシエチル 20.0 質量部、メルカプトエタノール 4.0 質量部、PGMEA 30 質量部、 α, α' -アゾビスイソブチロニトリル (略称 AIBN) 1.0 質量部の混合溶液を 1.5 時間かけて滴下し、さらに 3 時間反応した。次に、窒素気流を止めて、この反応溶液を 80℃ に冷却し、カレンズ MOI (昭和電工社製) 8.74 質量部、ジラウリン酸ジブチルすず 0.125 質量部、*p*-メトキシフェノール 0.125 質量部、及び PGMEA 10 質量部、を加えて 3 時間攪拌することで、マクロモノマー MM-1 の 49.5 質量% 溶液を得た。得られたマクロモノマー MM-1 を、GPC (ゲルパーミエーションクロマトグラフィー) にて、*N*-メチルピロリドン、0.01 mol/L 臭化リチウム添加/ポリスチレン標準の条件で確認したところ、質量平均分子量 (M_w) 4040、数平均分子量 (M_n) 1930、分子量分布 (M_w/M_n) は 2.09 であった。

[0118] (合成例 3 マクロモノマー MM-2 の合成)

冷却管、添加用ポート、窒素用インレット、機械的攪拌機、デジタル温度

計を備えた反応器に、PGMEA 80.0質量部を仕込み、窒素気流下撹拌しながら、温度90℃に加温した。メタクリル酸メチル100.0質量部、メルカプトエタノール4.0質量部、PGMEA 30質量部、AIBN 1.0質量部の混合溶液を1.5時間かけて滴下し、さらに3時間反応した。次に、窒素気流を止めて、この反応溶液を80℃に冷却し、カレンズMOI 8.74質量部、ジラウリン酸ジブチルスズ0.125質量部、p-メトキシフェノール0.125質量部、及びPGMEA 10質量部、を加えて3時間撹拌することで、マクロモノマーMM-2の49.8質量%溶液を得た。得られたマクロモノマーMM-2を、GPC（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）にて、N-メチルピロリドン、0.01mol/L臭化リチウム添加／ポリスチレン標準の条件で確認したところ、質量平均分子量（Mw）4130、数平均分子量（Mn）1940、分子量分布（Mw/Mn）は2.13であった。

[0119]（合成例4 グラフト共重合体GP-1の合成）

冷却管、添加用ロート、窒素用インレット、機械的撹拌機、デジタル温度計を備えた反応器に、PGMEA 80.0質量部を仕込み、窒素気流下撹拌しながら、温度85℃に加温した。合成例2のマクロモノマーMM-1溶液67.33質量部（有効固形分33.33質量部）、メタクリル酸2-（ジメチルアミノ）エチル（略称DMA）16.67質量部、n-ドデシルメルカプタン1.24質量部、PGMEA 20.0質量部、AIBN 0.5質量部の混合溶液混合溶液を1.5時間かけて滴下し、3時間加熱撹拌したのち、AIBN 0.10質量部、PGMEA 10.0質量部の混合液を10分かけて滴下し、さらに同温で1時間熟成することで、グラフト共重合体GP-1の26.0質量%溶液を得た。得られたグラフト共重合体GP-1は、GPC測定の結果、質量平均分子量（Mw）11510、数平均分子量（Mn）4730、分子量分布（Mw/Mn）は2.43であった。

[0120]（合成例5 グラフト共重合体GP-2の合成）

冷却管、添加用ロート、窒素用インレット、機械的撹拌機、デジタル温度

計を備えた反応器に、PGMEA 80.0質量部を仕込み、窒素気流下撹拌しながら、温度85℃に加温した。合成例3のマクロモノマーMM-2溶液66.93質量部（有効固形分33.33質量部）、DMA 16.67質量部、n-ドデシルメルカプタン1.24質量部、PGMEA 20.0質量部、AIBN 0.5質量部の混合溶液混合溶液を1.5時間かけて滴下し、3時間加熱撹拌したのち、AIBN 0.10質量部、PGMEA 10.0質量部の混合液を10分かけて滴下し、さらに同温で1時間熟成することで、グラフト共重合体GP-2の26.2質量%溶液を得た。得られたグラフト共重合体GP-2は、GPC測定の結果、質量平均分子量（Mw）11230、数平均分子量（Mn）4350、分子量分布（Mw/Mn）は2.58であった。

[0121]（合成例6 グラフト共重合体GP-3の合成）

冷却管、添加用ポート、窒素用インレット、機械的撹拌機、デジタル温度計を備えた反応器に、PGMEA 80.0質量部を仕込み、窒素気流下撹拌しながら、温度85℃に加温した。合成例2のマクロモノマーMM-1溶液50.50質量部（有効固形分25.00質量部）、プラクセルFA-10Lを11.9質量部（ダイセル化学社製 ヒドロキシエチルアクリレートにカプロラクトン10mol付加品 70%溶液 有効固形分8.33質量部）、DMA 16.67質量部、n-ドデシルメルカプタン1.24質量部、PGMEA 30.0質量部、AIBN 0.5質量部の混合溶液混合溶液を1.5時間かけて滴下し、3時間加熱撹拌したのち、AIBN 0.10質量部、PGMEA 10.0質量部の混合液を10分かけて滴下し、さらに同温で1時間熟成することで、グラフト共重合体GP-3の25.8質量%溶液を得た。得られたグラフト共重合体GP-3は、GPC測定の結果、質量平均分子量（Mw）12700、数平均分子量（Mn）4880、分子量分布（Mw/Mn）は2.60であった。

[0122]（合成例7 有機ホスホン酸エステル化合物1の合成）

冷却管、添加用ポート、窒素用インレット、機械的撹拌機、デジタル温度

計を備えた反応器に、ジエチレングリコールエチルメチルエーテル（EMDG）142.61質量部とフェニルホスホン酸（商品名：PPA、日産化学社製）50.00質量部、p-メトキシフェノール0.10質量部を仕込み、窒素気流下攪拌しながら、温度120℃まで加温した。メタクリル酸グリシジル（GMA）44.96質量部を30分かけて滴下し、2時間加熱攪拌することで、PPAの2価の酸性基の半分がGMAのエポキシ基とエステル化した有機ホスホン酸モノエステル化合物を含む有機ホスホン酸エステル化合物1（PPA-GMA）の40.0質量%溶液を得た。エステル化反応の進行は酸価測定により、生成物の組成比は³¹P-NMR測定により確認した。酸価は190mg KOH/gであり、有機ホスホン酸モノエステル化合物が55%、有機ホスホン酸ジエステル化合物が23%、PPAが22%の組成比であった。

[0123]（製造例1 分散剤溶液Aの調製）

100mLナスフラスコ中で、PGMEA13.74質量部に、合成例4のグラフト共重合体GP-1溶液35.49質量部（有効固形分9.23質量部）を溶解させ、更に、フェニルホスホン酸（商品名：PPA、日産化学社製）0.77質量部（グラフト共重合体の3級アミノ基に対して0.25モル当量）を加え、40℃で30分攪拌することで分散剤溶液A（固形分20質量%）を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、フェニルホスホン酸と酸・塩基反応により塩形成されている。

[0124]（製造例2 分散剤溶液Bの調製）

製造例1において、PGMEA13.90質量部、合成例4のグラフト共重合体GP-1溶液35.27質量部（有効固形分9.17質量部）、フェニルホスホン酸の代わりに、フェニルホスフィン酸0.83質量部（グラフト共重合体のアミノ基に対して0.3モル当量）を用いた以外は、製造例1と同様にして、分散剤溶液Bを調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、フェニルホスフィン酸と酸-塩基反応により塩形成されている。

[0125]（製造例3 分散剤溶液Cの調製）

製造例 1 において、PGMEA 14.14 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 34.95 質量部（有効固形分 9.09 質量部）、フェニルホスホン酸の代わりに、ベンゼンスルホン酸 0.91 質量部（グラフト共重合体のアミノ基に対して 0.3 モル当量）を用いた以外は、製造例 1 と同様にして、分散剤溶液 C を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、ベンゼンスルホン酸と酸-塩基反応により塩形成されている。

[0126]（製造例 4 分散剤溶液 D の調製）

製造例 1 において、PGMEA 12.73 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 36.86 質量部（有効固形分 9.58 質量部）、フェニルホスホン酸の代わりに、ホスホン酸 0.42 質量部（グラフト共重合体のアミノ基に対して 0.25 モル当量）を用いた以外は、製造例 1 と同様にして、分散剤溶液 D を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、ホスホン酸と酸-塩基反応により塩形成されている。

[0127]（製造例 5 分散剤溶液 E の調製）

製造例 1 において、PGMEA 12.29 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 36.91 質量部（有効固形分 9.60 質量部）、フェニルホスホン酸の代わりに、ホスフィン酸 50 質量%水溶液 0.80 質量部（有効固形分 0.40 質量部、グラフト共重合体のアミノ基に対して 0.3 モル当量）を用いた以外は、製造例 1 と同様にして、分散剤溶液 E を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、ホスフィン酸と酸-塩基反応により塩形成されている。

[0128]（製造例 6 分散剤溶液 F の調製）

製造例 1 において、PGMEA 13.70 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 32.30 質量部（有効固形分 8.40 質量部）、フェニルホスホン酸の代わりに、合成例 7 で得られた有機ホスホン酸エステル化合物 1（PPA-GMA）4.00 質量部（有効固形分 1.60 質量部、グラフト共重合体のアミノ基に対して 0.3 モル当量）を用いた以外は、製造例 1 と同様にして、分散剤溶液 F を調製した。このとき、グラフト共重合体

のアミノ基は、有機ホスホン酸エステル化合物 1 と酸-塩基反応により塩形成されている。

[0129] (製造例 7 分散剤溶液 G の調製)

製造例 2 において、PGMEA 14.17 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液の代わりに、合成例 5 のグラフト共重合体 GP-2 溶液 35.00 質量部（有効固形分 9.17 質量部）を用いた以外は、製造例 2 と同様にして、分散剤溶液 G を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、フェニルホスフィン酸と酸-塩基反応により塩形成されている。

[0130] (製造例 8 分散剤溶液 H の調製)

製造例 2 において、PGMEA 13.62 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液の代わりに、合成例 6 のグラフト共重合体 GP-3 溶液 35.55 質量部（有効固形分 9.17 質量部）を用いた以外は、製造例 2 と同様にして、分散剤溶液 H を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、フェニルホスフィン酸と酸-塩基反応により塩形成されている。

[0131] (製造例 9 分散剤溶液 I の調製)

100 mL ナスフラスコ中で、PGMEA 13.66 質量部に、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 35.60 質量部（有効固形分 9.25 質量部）を溶解させ、更に、塩化ベンジル 0.75 質量部（グラフト共重合体の 3 級アミノ基に対して 0.3 モル当量）を加え、120℃で 2 時間攪拌することで分散剤溶液 I（固形分 20 質量%）を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、塩化ベンジルと四級化反応により塩形成されている。

[0132] (製造例 10 分散剤溶液 J の調製)

製造例 9 において、PGMEA 12.86 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 36.68 質量部（有効固形分 9.54 質量部）、塩化ベンジルの代わりに、塩化アリル 0.46 質量部（グラフト共重合体のアミノ基に対して 0.3 モル当量）を用いた以外は、製造例 9 と同様にして、分散剤溶液 J を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、塩化ア

リルと四級化反応により塩形成されている。

[0133] (製造例 1 1 分散剤溶液 K の調製)

製造例 1 において、PGMEA 13.57 質量部、合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 35.71 質量部（有効固形分 9.29 質量部）、フェニルホスホン酸の代わりに、臭化アリル 0.71 質量部（グラフト共重合体のアミノ基に対して 0.3 モル当量）を用いた以外は、製造例 1 と同様にして、分散剤溶液 K を調製した。このとき、グラフト共重合体のアミノ基は、臭化アリルと四級化反応により塩形成されている。

[0134] (実施例 1 金属粒子分散体 A の調製)

合成例 1 で得られた銅粒子 40.0 質量部、製造例 1 で得られた分散剤溶液 A 15.0 質量部（有効固形分 3.0 質量部）、PGMEA 45.0 質量部を混合し、ペイントシェーカー（浅田鉄工社製）にて予備分散として 2 mm ジルコニアビーズで 1 時間、さらに本分散として 0.1 mm ジルコニアビーズで 4 時間分散し、実施例 1 の金属粒子分散体 A を得た。

[0135] (実施例 2 ~ 1 1 金属粒子分散体 B ~ K の調製)

実施例 1 において、分散剤溶液 A の代わりに、製造例 2 ~ 1 1 で得られた分散剤溶液 B ~ K をそれぞれ用いた以外は、実施例 1 と同様にして、実施例 2 ~ 1 1 の金属粒子分散体 B ~ K を得た。

[0136] (比較例 1 金属粒子分散体 X 1 の調製)

実施例 1 において、分散剤溶液 A の代わりに、塩形成していない合成例 4 のグラフト共重合体 GP-1 溶液 11.54 質量部（有効固形分 3.0 質量部）を用い、PGMEA 48.46 質量部とした以外は、実施例 1 と同様にして、比較例 1 の金属粒子分散体 X 1 を得た。

[0137] (比較例 2 金属粒子分散体 X 2 の調製)

実施例 1 において、分散剤溶液 A の代わりに、ソルスパース 71000（日本ルーブリゾール社製）3.0 質量部、PGMEA 57.0 質量部を用いた以外は、実施例 1 と同様にして、比較例 2 の金属粒子分散体 X 2 を得た。

[0138] (比較例 3 金属粒子分散体 X 3 の調製)

実施例 1 において、分散剤溶液 A の代わりに、BYK-111（ビッケミー社製）3.0 質量部、PGMEA 57.0 質量部を用いた以外は、実施例 1 と同様にして、比較例 3 の金属粒子分散体 X 3 を得た。

[0139]（比較例 4 金属粒子分散体 X 4 の調製）

実施例 1 において、分散剤溶液 A の代わりに、BYK-161（ビッケミー社製）10.0 質量部（有効固形分 3.0 質量部）、PGMEA 50.0 質量部を用いた以外は、実施例 1 と同様にして、比較例 4 の金属粒子分散体 X 4 を得た。

[0140]（比較例 5 金属粒子分散体 X 5 の調製）

実施例 1 において、分散剤溶液 A の代わりに、アジスパー PB821（味の素ファインテクノ社製）3.0 質量部、PGMEA 57.0 質量部を用いた以外は、実施例 1 と同様にして、比較例 5 の金属粒子分散体 X 5 を得た。

[0141]（評価）

<分散性評価>

金属粒子の分散性の評価として、各実施例及び比較例で得られた金属粒子分散体中の金属粒子の平均粒径とせん断粘度の測定を行った。平均粒径の測定には、日機装社製「ナノトラック粒度分布計UPA-EX150」を用い、粘度測定には、Anton Paar社製「レオメータMCR301」を用いて、せん断速度が60rpmのときのせん断粘度を測定した。結果を表 1 に示す。

[0142] <沈降物評価>

各実施例及び比較例で得られた金属粒子分散体を、冷蔵で1週間静置し、静置後の金属微粒子分散体中の沈降物を目視で観察した。結果を表 1 に示す。

沈降物がなければ分散安定性に優れているといえる。

[0143] <焼結評価>

（1）導電性基板の作製

各実施例及び比較例で得られた金属粒子分散体を、ガラス基板（商品名：

OA-10G、日本電気硝子社製、厚さ0.7mm)上にワイヤーバーで塗布して、80℃で15分乾燥して、膜厚が2μmの塗膜とした。得られた塗布膜を、300℃、水素3体積%/窒素97体積%の混合ガス雰囲気下で30分焼成し、導電性基板を得た。

[0144] (2) シート抵抗値の測定

表面抵抗計(ダイアインスツルメンツ社製「ロレスタGP」、PSPタイププローブ)を用いて、上記(1)で得られた実施例1~11及び比較例1~5の基板の焼結膜に4探針を接触させ、4探針法によりシート抵抗値を測定した。結果を表1に示す。

シート抵抗値が低ければ、低温焼結性に優れ、有機成分の残存が少ないといえる。なお、本測定法によるシート抵抗値の測定上限は $10^8 \Omega/\square$ であった。

[0145] [表1]

表1.

	顔料分散剤		分散性評価			シート抵抗値 ($\Omega/\square$)
	重合体	塩形成剤	粒径 (nm)	粘度 (mPa·s)	沈降物	
実施例1	GP-1	フェニルホスホン酸	55	2.9	なし	0.55
実施例2	GP-1	フェニルホスフィン酸	62	2.7	なし	0.39
実施例3	GP-1	ベンゼンスルホン酸	54	2.5	なし	0.95
実施例4	GP-1	ホスホン酸	52	2.5	なし	0.59
実施例5	GP-1	ホスフィン酸	63	2.4	なし	0.62
実施例6	GP-1	有機ホスホン酸 エステル化合物1	65	2.5	なし	0.77
実施例7	GP-2	フェニルホスフィン酸	60	2.8	なし	0.42
実施例8	GP-3	フェニルホスフィン酸	65	2.9	なし	0.58
実施例9	GP-1	塩化ベンジル	75	2.6	なし	0.88
実施例10	GP-1	塩化アリル	47	2.5	なし	0.55
実施例11	GP-1	臭化アリル	47	2.5	なし	0.42
比較例1	GP-1	なし	68	4.0	あり	0.35
比較例2	ソルスパス71000		71	6.3	あり	over load
比較例3	BYK-111		56	1.7	あり	over load
比較例4	BYK-161		117	5.0	あり	over load
比較例5	アジスパーPB821		58	4.0	あり	over load

[0146] 表1の結果から、分散剤として、一般式(1)で表される構成単位と、一般式(11)で表される構成単位とを有し、前記一般式(1)で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、特定の

酸性リン化合物、及び特定のスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも１種とが塩を形成したグラフト共重合体を用いた、実施例１～１１の金属粒子分散体は、分散性、分散安定性に優れ、沈降物を生じることがなく、更に低温焼結に適していることが明らかとなった。一般式（Ⅰ）で表される構成単位と、一般式（ⅠⅠ）で表される構成単位とを有するが、塩形成していない分散剤を用いた、比較例１の金属粒子分散体は、沈降物が生じ分散安定性が悪かった。また、その他の市販の分散剤を用いた比較例２～５の金属粒子分散体は、沈降物が生じ分散安定性が悪かった。また、比較例２～５は、シート抵抗値が高く、低温焼結性が悪いことが明らかとなった。

[0147] （合成例８ 銀粒子の製造）

硝酸銀５０ｇと純水２００ｍＬの混合液に、ポリメタクリル酸２－ジメチルアミノエチル（質量平均分子量２０００）５ｇと５０ｍＬの純水に混合した液を添加し、１時間かけて硝酸銀と反応させて、銀粒子を生成させた。その後、濾過洗浄し、乾燥することで、銀粒子を得た。得られた銀粒子を走査透過型電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）で観察したところ、平均一次粒径は、４０ｎｍであった。

[0148] （実施例１２ 金属粒子分散体Ｌの調製）

合成例８で得られた銀粒子１０．０質量部、製造例２で得られた分散剤溶液Ｂ３０．０質量部（有効固形分６．０質量部）、ＰＧＭＥＡ６０．０質量部を混合し、ペイントシェーカーにて予備分散として２ｍｍジルコニアビーズで１時間、さらに本分散として０．１ｍｍジルコニアビーズで８時間分散し、実施例１２の金属粒子分散体Ｌを得た。

[0149] （実施例１３ 金属粒子分散体Ｍの調製）

実施例１２において、銀粒子の代わりに、モリブデン粒子（シグマアルドリッチ社製、１００ｎｍ以下）を用い、本分散時間を６時間とした以外は、実施例１２と同様にして、実施例１３の金属粒子分散体Ｍを得た。

[0150] （実施例１４ 金属粒子分散体Ｎの調製）

実施例１２において、銀粒子の代わりに、アルミナ粒子（シグマアルドリ

ッチ社製、100nm以下)を用い、本分散時間を2時間とした以外は、実施例12と同様にして、実施例14の金属粒子分散体Nを得た。

[0151] (実施例15 金属粒子分散体Oの調製)

A T O粒子(スズドープ酸化アンチモン粒子、「T-1-20L」三菱マテリアル社製、平均粒径20nm)10.0質量部、製造例2で得られた分散剤溶液B15.0質量部(有効固形分3.0質量部)、PGMEA75.0質量部を混合し、ペイントシェーカーにて予備分散として2mmジルコニアビーズで1時間、さらに本分散として0.1mmジルコニアビーズで24時間分散し、実施例15の金属粒子分散体Oを得た。

[0152] (実施例16 金属粒子分散体Pの調製)

実施例15において、分散剤溶液Bの代わりに、製造例11の分散剤溶液Kを用いた以外は、実施例15と同様にして、実施例16の金属粒子分散体Pを得た。

[0153] (実施例17 金属粒子分散体Qの調製)

実施例15において、A T O粒子の代わりに、I T O粒子(スズドープ酸化インジウム粒子、「ナノテックI T O-R」シーアイ化成社製、平均粒径30nm)を用い、本分散時間を12時間とした以外は、実施例15と同様にして、実施例17の金属粒子分散体Qを得た。

[0154] (評価)

<分散性評価>

金属粒子の分散性の評価として、実施例12~17で得られた金属粒子分散体中の金属粒子の平均粒径とせん断粘度の測定を行った。平均粒径の測定には、日機装社製「ナノトラック粒度分布計UPA-EX150」を用い、粘度測定には、Anton Paar社製「レオメータMCR301」を用いて、せん断速度が60rpmのときのせん断粘度を測定した。結果を表2に示す。

[0155] <沈降物評価>

実施例12~17で得られた金属粒子分散体を、冷蔵で1週間静置し、静

置後の金属微粒子分散体中の沈降物を目視で観察した。結果を表2に示す。

沈降物がなければ分散安定性に優れているといえる。

[0156] [表2]

表 2

	金属粒子	分散剤		分散性評価		
		重合体	変性剤	粒径 (nm)	粘度 (mP・s)	沈降物
実施例 12	銀	GP-1	フェニルホスフィン酸	82	2.0	なし
実施例 13	モリブデン	GP-1	フェニルホスフィン酸	72	1.8	なし
実施例 14	アルミナ	GP-1	フェニルホスフィン酸	102	2.7	なし
実施例 15	ATO	GP-1	フェニルホスフィン酸	28	2.4	なし
実施例 16	ATO	GP-1	臭化アリル	32	2.5	なし
実施例 17	ITO	GP-1	フェニルホスフィン酸	55	2.1	なし

[0157] 表2の結果の通り、分散剤として、一般式(1)で表される構成単位と、一般式(11)で表される構成単位とを有し、前記一般式(1)で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、特定の酸性リン化合物、及び特定のスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも1種とが塩を形成したグラフト共重合体を用いた、金属粒子分散体は、金属粒子が銅以外であっても、分散性、分散安定性に優れ、沈降物を生じることがなかった。

[0158] (実施例18 熱線吸収フィルムの作製)

実施例17の金属粒子分散体Q4、81質量部、ペンタエリスリトールトリアクリレート1、78質量部、イルガキュア814(BASF社製)0、10質量部を混合しインキを調製した。インキをPETフィルム上に10 μ mの膜厚となるように塗布し、70℃のオーブンで3分乾燥させた後、窒素雰囲気下で紫外線露光機により300mJ/cm²の紫外線を照射することで

硬化塗膜を作製した。

[0159] (評価)

<透過率測定>

実施例 18 の硬化塗膜を、分光光度計（島津製作所社製 UV 3100）を用いて 300 ～ 3000 nm の波長領域の透過率を測定した。

表 3 に赤外線透過率（1200 nm の透過率）及び可視光透過率（650 nm の透過率）の測定結果を示す。

[0160] [表3]

表 3

	透過率(%)	
	可視光 (650nm)	赤外光 (1200nm)
実施例 18	85.4	39.8

[0161] (合成例 9 マクロモノマー MM-3 の合成)

冷却管、添加用ロート、窒素用インレット、機械的攪拌機、デジタル温度計を備えた反応器に、PGMEA 80.0 質量部を仕込み、窒素気流下攪拌しながら、温度 90℃ に加温した。メタクリル酸イソブチル 100.0 質量部、メルカプトエタノール 4.0 質量部、PGMEA 30.0 質量部、AIBN 1.0 質量部の混合溶液を 1.5 時間かけて滴下し、さらに 3 時間反応した。次に、窒素気流を止めて、この反応溶液を 80℃ に冷却し、カレンズ MOI 8.74 質量部、ジラウリン酸ジブチルすず 0.125 質量部、p-メトキシフェノール 0.125 質量部、及び PGMEA 10.0 質量部、を加えて 3 時間攪拌することで、マクロモノマー MM-3 の 50.0 質量% 溶液を得た。得られたマクロモノマー MM-3 を、GPC（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）にて、N-メチルピロリドン、0.01 mol/L 臭化リチウム添加／ポリスチレン標準の条件で確認したところ、質量平均分子量 (Mw) 3720、数平均分子量 (Mn) 1737、分子量分布 (Mw/Mn) は 2.14 であった。

[0162] (合成例 10 グラフト共重合体 GP-4 の合成)

冷却管、添加用ロート、窒素用インレット、機械的攪拌機、デジタル温度計を備えた反応器に、PGMEA 80.0 質量部を仕込み、窒素気流下攪拌しながら、温度 85℃ に加温した。合成例 9 のマクロモノマー MM-3 溶液 66.66 質量部（有効固形分 33.33 質量部）、メタクリル酸 2-（ジメチルアミノ）エチル（略称 DMA）16.67 質量部、n-ドデシルメルカプタン 1.24 質量部、PGMEA 25.0 質量部、AIBN 0.5 質量部の混合溶液混合溶液を 1.5 時間かけて滴下し、3 時間加熱攪拌したのち、AIBN 0.10 質量部、PGMEA 10.0 質量部の混合液を 10 分かけて滴下し、さらに同温で 1 時間熟成することで、グラフト共重合体 GP-4 の 25.2 質量% 溶液を得た。得られたグラフト共重合体 GP-4 は、GPC 測定の結果、質量平均分子量（Mw）13063、数平均分子量（Mn）5259、分子量分布（Mw/Mn）は 2.42 であった。

[0163] (合成例 11 グラフト共重合体 GP-5 の合成)

冷却管、添加用ロート、窒素用インレット、機械的攪拌機、デジタル温度計を備えた反応器に、PGMEA 80.0 質量部を仕込み、窒素気流下攪拌しながら、温度 85℃ に加温した。合成例 9 のマクロモノマー MM-3 溶液 90.0 質量部（有効固形分 45.0 質量部）、DMA 5.0 質量部、n-ドデシルメルカプタン 1.24 質量部、PGMEA 10.0 質量部、AIBN 0.5 質量部の混合溶液混合溶液を 1.5 時間かけて滴下し、3 時間加熱攪拌したのち、AIBN 0.10 質量部、PGMEA 10.0 質量部の混合液を 10 分かけて滴下し、さらに同温で 1 時間熟成することで、グラフト共重合体 GP-5 の 27.0 質量% 溶液を得た。得られたグラフト共重合体 GP-5 は、GPC 測定の結果、質量平均分子量（Mw）12761、数平均分子量（Mn）5482、分子量分布（Mw/Mn）は 2.33 であった。

[0164] (製造例 12 分散剤溶液 L の調製)

100 mL ナスフラスコ中で、PGMEA 11.19 質量部に、合成例 10 のグラフト共重合体 GP-4 溶液 33.16 質量部（有効固形分 8.36

質量部)を溶解させ、更に、臭化アリル0.64質量部(グラフト共重合体の3級アミノ基に対して0.3モル当量)を加え、40℃で30分攪拌することで分散剤溶液L(固形分20質量%)を調製した。このとき、グラフト共重合体GP-4のアミノ基は、臭化アリルと四級化反応により塩形成されている。

[0165] (製造例13 分散剤溶液Mの調製)

製造例12において、PGMEA13.41質量部、合成例11のグラフト共重合体GP-5溶液30.95質量部(有効固形分8.36質量部)、臭化アリル0.64質量部(グラフト共重合体のアミノ基に対して1.0モル当量)を用いた以外は、製造例1と同様に、分散剤溶液M(固形分20質量%)を調製した。このとき、グラフト共重合体GP-5のアミノ基は、臭化アリルと四級化反応により塩形成されている。

[0166] (合成例12 CuInGaS粒子の製造)

ビス(2,4-ペンタンジオナト)銅(II)5.11g、トリス(2,4-ペンタンジオナト)インジウム(III)6.47g、トリス(2,4-ペンタンジオナト)ガリウム(III)3.04gにオレイルアミン50mlを仕込み、窒素気流下攪拌しながら、温度150℃で10分間加温した。285℃まで加温した後、オレイルアミン60mlに溶解させた硫黄2.45gを注入して30分間反応させた。室温に戻し、イソプロピルアルコール(IPA)を加えることで生成物を沈殿させ、遠心分離操作により生成物を分離し、乾燥することで、CuInGaS粒子を得た。

[0167] (実施例19 金属粒子分散体Rの調製)

合成例12で得られたCuInGaS粒子、製造例12で得られた分散剤溶液L15.0質量部(有効固形分3.0質量部)、メチルイソブチルケトン(MIBK)75.0質量部を混合し、ペイントシェーカー(浅田鉄工社製)にて予備分散として2mmジルコニアビーズで1時間、さらに本分散として0.1mmジルコニアビーズで1時間分散し、実施例19の金属粒子分散体Rを得た。

[0168] (実施例 20 金属粒子分散体 S の調製)

実施例 19 において、分散剤溶液 L の代わりに、製造例 13 で得られた分散剤溶液 M を用いた以外は、実施例 19 と同様にして、実施例 20 の金属粒子分散体 S を得た。

[0169] (実施例 21 金属粒子分散体 T の調製)

硫化銅 (Alfa Aesar 社製) 4.3 質量部、硫化インジウム (Alfa Aesar 社製) 4.4 質量部、硫化ガリウム (Aldrich 社製) 1.3 質量部、製造例 12 で得られた分散剤溶液 L 15.0 質量部 (有効固形分 3.0 質量部)、MIBK 75.0 質量部を混合し、ペイントシェーカーにて予備分散として 2 mm ジルコニアビーズで 1 時間、さらに本分散として 0.1 mm ジルコニアビーズで 3 時間分散し、実施例 21 の金属粒子分散体 T を得た。

[0170] (比較例 6 金属粒子分散体 U の調製)

実施例 19 において、分散剤溶液 L の代わりに、オレイルアミン 3.0 質量部、MIBK 97.0 質量部とした以外は、実施例 19 と同様にして、比較例 6 の金属粒子分散体 U を得た。

[0171] (比較例 7 金属粒子分散体 V の調製)

実施例 19 において、分散剤溶液 L の代わりに、PB822 (味の素ファインテクノ社製) 3.0 質量部、MIBK 97.0 質量部とした以外は、実施例 19 と同様にして、比較例 7 の金属粒子分散体 V を得た。

[0172] (比較例 8 金属粒子分散体 W の調製)

実施例 19 において、分散剤溶液 L の代わりに、BYK-180 (ビックケミー社製) 3.0 質量部、MIBK 97.0 質量部とした以外は、実施例 19 と同様にして、比較例 8 の金属粒子分散体 W を得た。

[0173] (評価)

<分散安定性評価>

金属粒子の分散安定性の評価として、実施例 19～21 及び比較例 6～8 で得られた金属粒子分散体を、室温で静置し、金属粒子の堆積が始まるまで

の日数を計測した。

結果を表4に示す。

[0174] <残留カーボン量評価>

(1) CuInGaS薄膜の作製

実施例19～21及び比較例6～8で得られた金属粒子分散体を、ガラス基板（商品名：OA-10G、日本電気硝子社製、厚さ0.7mm）上にスピナーで成膜して、80℃で1分乾燥して、膜厚が500nmの塗膜とした。得られた塗布膜を、350℃、大気下で5分焼成し、CuInGaS薄膜を得た。

[0175] (2) 残留カーボン量（C/Cu）測定

SEM-EDX装置（日立ハイテク社製「エネルギー分散型X線分析装置Quantax70」）を用い、上記（1）で得られた実施例19～21及び比較例6～8の薄膜のCu原子濃度数およびC原子濃度数を測定し、C原子濃度数/Cu原子濃度数より残留カーボン量を算出した。結果を表4に示す。

残留カーボン量の値が小さいほど、膜中の有機成分の残存が少ないといえる。

[0176]

[表4]

表4

	金属 粒子	分散剤		評価	
		重合体	変性剤	分散安定性	CIGS薄膜の 残留カーボン量
実施例 19	CuInGaS	GP-4	臭化アリル	2ヶ月以上	0.66
実施例 20	CuInGaS	GP-5	臭化アリル	2ヶ月以上	0.69
実施例 21	CuS, InS, GaS	GP-4	臭化アリル	2ヶ月以上	0.78
比較例 6	CuInGaS	オレイルアミン		3日	2.13
比較例 7	CuInGaS	アジスパーPB822		1ヶ月で ゲル化	1.56
比較例 8	CuInGaS	BYK-180		分散せず	膜にならず 測定不能

符号の説明

- [0177]
- 1 基材
 - 2 金属膜
 - 3 薄膜
 - 4 金属粒子
 - 5 塗膜
 - 10 金属含有層
 - 100 基板

請求の範囲

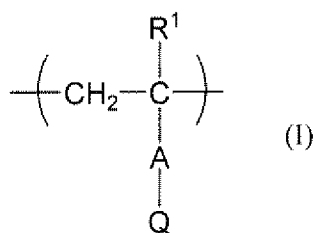
[請求項1]

金属粒子と、分散剤と、溶剤とを含有し、

前記金属粒子は、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、及びゲルマニウムよりなる群から選択される1種以上を含む金属粒子であり、且つ、

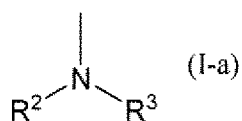
前記分散剤は、下記一般式（I）で表される構成単位と、下記一般式（I'）で表される構成単位とを有し、前記一般式（I）で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、下記一般式（V）で表される酸性リン化合物、及び下記一般式（V'）で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも1種とが塩を形成したグラフト共重合体である、金属粒子分散体。

[化1]



（一般式（I）中、Aは、直接結合又は2価の連結基、R¹は、水素原子又はメチル基、Qは、下記一般式（I-a）で表される基、又は、置換基を有していても良い、塩形成可能な含窒素複素環基を表す。）

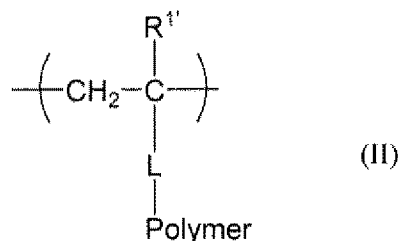
[化2]



（一般式（I-a）中、R²及びR³は、それぞれ独立して、水素原

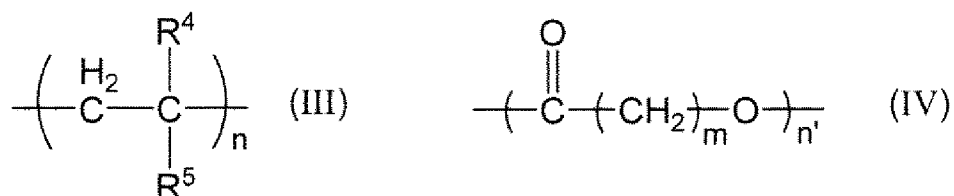
子又はヘテロ原子を含んでもよい炭化水素基を表し、 R^2 及び R^3 は互いに同一であっても異なってもよい。)

[化3]



(一般式(II)中、 $R^{1'}$ は、水素原子又はメチル基、 L は、直接結合又は2価の連結基、 $Polymer$ は、下記一般式(III)又は一般式(IV)で表される構成単位を少なくとも1種有するポリマー鎖を表す。)

[化4]



(一般式(III)及び、一般式(IV)中、 R^4 は水素原子又はメチル基であり、 R^5 は炭化水素基、シアノ基、 $-[CH(R^6)-CH(R^7)-O]_x-R^8$ 、 $-[(CH_2)_y-O]_z-R^8$ 、 $-[CO-(CH_2)_y-O]_z-R^8$ 、 $-CO-O-R^9$ 又は $-O-CO-R^{10}$ で示される1価の基である。 R^6 及び R^7 は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基である。

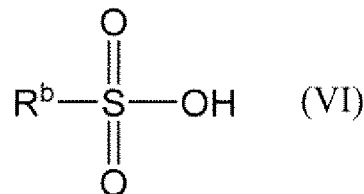
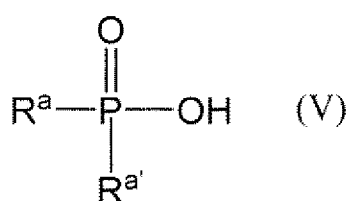
R^8 は、水素原子、炭化水素基、 $-CHO$ 、 $-CH_2CHO$ 又は $-CH_2COOR^{11}$ で示される1価の基であり、 R^9 は、炭化水素基、シアノ基、 $-[CH(R^6)-CH(R^7)-O]_x-R^8$ 、 $-[(CH_2)_y-O]_z-R^8$ 、又は $-[CO-(CH_2)_y-O]_z-R^8$ で示される1価の基である。 R^{10} は、炭素数1～18のアルキル基であ

り、 R^{11} は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基を示す。

上記炭化水素基は、置換基を有していてもよい。

m は1～5の整数、 n 及び n' は5～200の整数を示す。 x は1～18の整数、 y は1～5の整数、 z は1～18の整数を示す。）

[化5]



(一般式(V)及び一般式(VI)中、 R^a 及び $R^{a'}$ はそれぞれ独立に、水素原子、水酸基、炭化水素基、 $-\text{CH}(\text{R}^c)-\text{CH}(\text{R}^d)-\text{O}]_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2)_t-\text{O}]_u-\text{R}^e$ 、又は $-\text{O}-\text{R}^{a'}$ で示される1価の基である。 $R^{a'}$ は、炭化水素基、 $-\text{CH}(\text{R}^c)-\text{CH}(\text{R}^d)-\text{O}]_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2)_t-\text{O}]_u-\text{R}^e$ 、 $-\text{C}(\text{R}^f)(\text{R}^g)-\text{C}(\text{R}^h)(\text{R}^i)-\text{OH}$ 、又は、 $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{R}^j)(\text{R}^k)-\text{CH}_2-\text{OH}$ で示される1価の基である。

R^b は、炭化水素基、 $-\text{CH}(\text{R}^c)-\text{CH}(\text{R}^d)-\text{O}]_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2)_t-\text{O}]_u-\text{R}^e$ 、又は $-\text{O}-\text{R}^{b'}$ で示される1価の基である。 $R^{b'}$ は、炭化水素基、 $-\text{CH}(\text{R}^c)-\text{CH}(\text{R}^d)-\text{O}]_s-\text{R}^e$ 、又は $-\text{[(CH}_2)_t-\text{O}]_u-\text{R}^e$ で示される1価の基である。

R^c 及び R^d は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基であり、 R^e は、水素原子、炭化水素基、 $-\text{CHO}$ 、 $-\text{CH}_2\text{CHO}$ 、又は $-\text{CH}_2\text{COOR}^1$ で示される1価の基であり、 R^1 は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基である。 R^f 、 R^g 、 R^h 、 R^i 、 R^j 及び R^k は、それぞれ独立に、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基であって、 R^f

及び R^h は、互いに結合して環構造を形成してもよい。上記環状構造を形成した場合、置換基 R^n を有していてもよく、 R^n は、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基である。

R^a 、 $R^{a'}$ 、及び R^b において、炭化水素基はそれぞれ、置換基を有していてもよい。

s は1～18の整数、 t は1～5の整数、 u は1～18の整数を示す。)

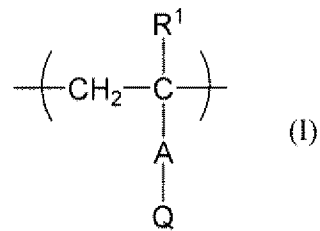
[請求項2] 前記金属粒子の平均一次粒径が5～200nmである、請求項1に記載の金属粒子分散体。

[請求項3] 請求項1又は2に記載の金属粒子分散体又は金属粒子分散体を含む組成物の塗膜、成形体又は焼結膜を含む、物品。

[請求項4] 金属粒子と、分散剤と、溶剤とを含有し、
前記金属粒子は、金、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、モリブデン、アルミニウム、アンチモン、スズ、クロム、ランタン、インジウム、ガリウム、亜鉛、及びゲルマニウムよりなる群から選択される1種以上を含む金属粒子であり、且つ、

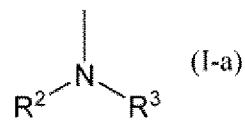
前記分散剤は、下記一般式(Ⅰ)で表される構成単位と、下記一般式(ⅠⅠ)で表される構成単位とを有し、前記一般式(Ⅰ)で表される構成単位に含まれる窒素部位の少なくとも一部と、ハロゲン化炭化水素、下記一般式(Ⅴ)で表される酸性リン化合物、及び下記一般式(ⅤⅠ)で表されるスルホン酸化合物よりなる群から選択される少なくとも1種とが塩を形成したグラフト共重合体である、焼結膜形成用金属粒子分散体。

[化6]



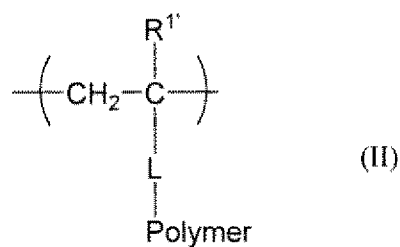
(一般式 (I) 中、Aは、直接結合又は2価の連結基、R¹は、水素原子又はメチル基、Qは、下記一般式 (I-a) で表される基、又は、置換基を有していても良い、塩形成可能な含窒素複素環基を表す。)

[化7]



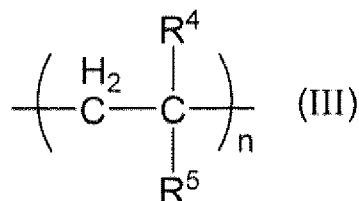
(一般式 (I-a) 中、R²及びR³は、それぞれ独立して、水素原子又はヘテロ原子を含んでもよい炭化水素基を表し、R²及びR³は互いに同一であっても異なってもよい。)

[化8]



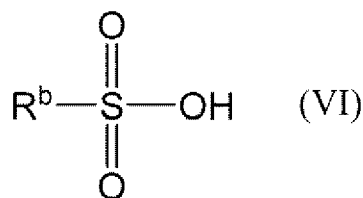
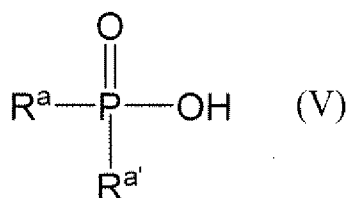
(一般式 (II) 中、R^{1'}は、水素原子又はメチル基、Lは、直接結合又は2価の連結基、Polymerは、下記一般式 (III) で表される構成単位を少なくとも1種有するポリマー鎖を表す。)

[化9]



(一般式 (I I I) 中、 R^4 は水素原子又はメチル基であり、 R^5 は炭素数3～18の分岐アルキル基、又は $-\text{CO}-\text{O}-\text{R}^9$ で示される1価の基である。 R^9 は、炭素数3～18の分岐アルキル基である。 n は5～200の整数を示す。)

[化10]



(一般式 (V) 及び一般式 (VI) 中、 R^a 及び $\text{R}^{a'}$ はそれぞれ独立に、水素原子、水酸基、炭化水素基、 $-\text{[CH(R}^c\text{)-CH(R}^d\text{)-O]}_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2\text{)}_t\text{-O]}_u-\text{R}^e$ 、又は $-\text{O}-\text{R}^{a''}$ で示される1価の基である。 $\text{R}^{a''}$ は、炭化水素基、 $-\text{[CH(R}^c\text{)-CH(R}^d\text{)-O]}_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2\text{)}_t\text{-O]}_u-\text{R}^e$ 、 $-\text{C(R}^f\text{)(R}^g\text{)-C(R}^h\text{)(R}^i\text{)-OH}$ 、又は、 $-\text{CH}_2-\text{C(R}^j\text{)(R}^k\text{)-CH}_2-\text{OH}$ で示される1価の基である。

R^b は、炭化水素基、 $-\text{[CH(R}^c\text{)-CH(R}^d\text{)-O]}_s-\text{R}^e$ 、 $-\text{[(CH}_2\text{)}_t\text{-O]}_u-\text{R}^e$ 、又は $-\text{O}-\text{R}^{b'}$ で示される1価の基である。 $\text{R}^{b'}$ は、炭化水素基、 $-\text{[CH(R}^c\text{)-CH(R}^d\text{)-O]}_s-\text{R}^e$ 、又は $-\text{[(CH}_2\text{)}_t\text{-O]}_u-\text{R}^e$ で示される1価の基である。

R^c 及び R^d は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基であり、 R^e

は、水素原子、炭化水素基、 $-CHO$ 、 $-CH_2CHO$ 、又は $-CH_2COOR^l$ で示される1価の基であり、 R^l は水素原子又は炭素数1～5のアルキル基である。 R^f 、 R^g 、 R^h 、 R^i 、 R^j 及び R^k は、それぞれ独立に、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基であって、 R^f 及び R^h は、互いに結合して環構造を形成してもよい。上記環状構造を形成した場合、置換基 R^n を有していてもよく、 R^n は、水素原子、炭化水素基、又は、炭化水素基をエーテル結合及びエステル結合の少なくとも1つで結合した基である。

R^a 、 $R^{a'}$ 、及び R^b において、炭化水素基はそれぞれ、置換基を有していてもよい。

s は1～18の整数、 t は1～5の整数、 u は1～18の整数を示す。)

[請求項5] 前記金属粒子が、下記(i)と(ii)と(iii)とを含む金属化合物を含有する、請求項4に記載の焼結膜形成用金属粒子分散体。

(i) 銅、

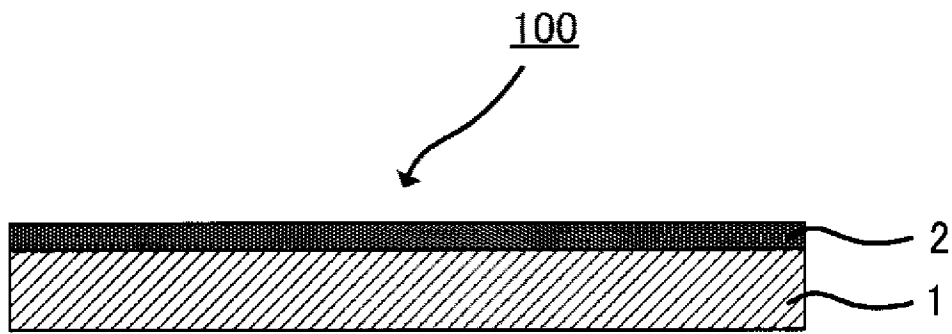
(ii) インジウム、ガリウム、亜鉛、スズ、及びアルミニウムよりなる群から選択される1種以上、

(iii) 硫黄、セレン、及びテルルよりなる群から選択される1種以上

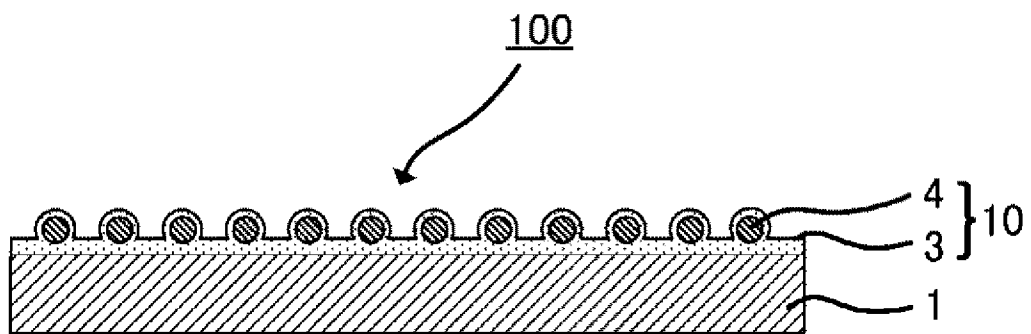
[請求項6] 請求項4又は5に記載の焼結膜形成用金属粒子分散体を含む組成物の塗膜が焼成されてなる、焼結膜。

[請求項7] 請求項4又は5に記載の焼結膜形成用金属粒子分散体を含む組成物を、基材上に塗布して塗膜を形成する工程と、当該塗膜を焼成処理する工程とを有する、焼結膜の製造方法。

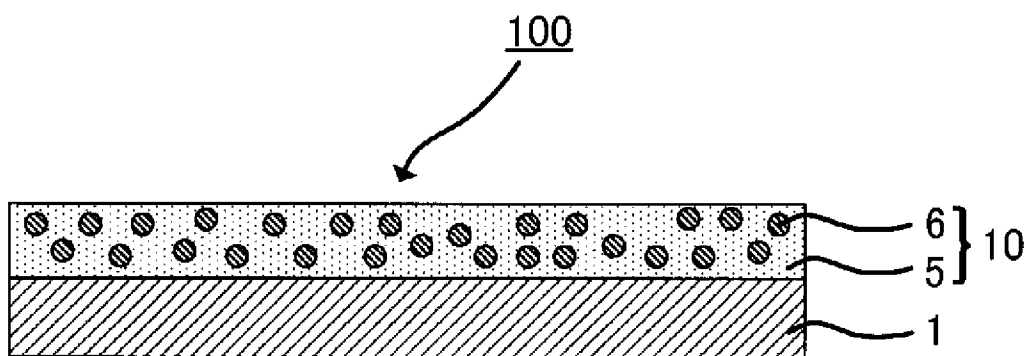
[図1]



[図2]



[図3]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/076335

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C08L51/00(2006.01)i, C08F265/06(2006.01)i, C08F290/04(2006.01)i, C08K3/08(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C08L1/00-101/14, C08F251/00-299/08, C08K3/00-13/08, H01B1/00-1/24

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2013
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2013	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2013

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2010-53171 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 11 March 2010 (11.03.2010), claims; paragraph [0060] (Family: none)	1-5 6, 7
Y	JP 2010-229544 A (Mitsuboshi Belting Ltd.), 14 October 2010 (14.10.2010), claims; paragraphs [0008], [0017] (Family: none)	6, 7
Y	WO 2011/040189 A1 (Dainippon Printing Co., Ltd.), 07 April 2011 (07.04.2011), claims; paragraphs [0002] to [0008] & US 2012/0267151 A1 & CN 102596455 A & KR 10-2012-0090987 A & CN 103170618 A	6, 7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
05 December, 2013 (05.12.13)

Date of mailing of the international search report
17 December, 2013 (17.12.13)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/076335

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2009-265649 A (Dainippon Printing Co., Ltd.), 12 November 2009 (12.11.2009), entire text (Family: none)	1-7
A	JP 2009-203462 A (Fujifilm Corp.), 10 September 2009 (10.09.2009), claims; paragraphs [0029], [0038] & US 2011/0003241 A1 & EP 2246385 A1 & WO 2009/096452 A1 & CN 101925636 A & KR 10-2010-0119874 A & TW 200940598 A	1-7
P, A	JP 2012-255148 A (Fujifilm Corp.), 27 December 2012 (27.12.2012), claims; paragraphs [0035], [0043] (Family: none)	1-7
A	JP 2005-118723 A (Sanyo Chemical Industries, Ltd.), 12 May 2005 (12.05.2005), claim 5; paragraph [0009] (Family: none)	1-7

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. C08L51/00(2006.01)i, C08F265/06(2006.01)i, C08F290/04(2006.01)i, C08K3/08(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. C08L1/00-101/14, C08F251/00-299/08, C08K3/00-13/08, H01B1/00-1/24

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 3 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 3 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 3 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 2010-53171 A（大日本印刷株式会社）2010.03.11, 【特許請求の範囲】、段落【0060】 （ファミリーなし）	1-5 6, 7
Y	JP 2010-229544 A（三ツ星ベルト株式会社）2010.10.14, 【特許請求の範囲】、段落【0008】【0017】 （ファミリーなし）	6, 7
Y	WO 2011/040189 A1（大日本印刷株式会社）2011.04.07,	6, 7

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 5 . 1 2 . 2 0 1 3

国際調査報告の発送日

1 7 . 1 2 . 2 0 1 3

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

細井 龍史

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 5 7

4 J

9 4 4 6

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
	請求の範囲、段落[0002]-[0008] & US 2012/0267151 A1 & CN 102596455 A & KR 10-2012-0090987 A & CN 103170618 A	
A	JP 2009-265649 A (大日本印刷株式会社) 2009. 11. 12, 全文 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 2009-203462 A (富士フイルム株式会社) 2009. 09. 10, 【特許請求の範囲】、段落【0029】【0038】 & US 2011/0003241 A1 & EP 2246385 A1 & WO 2009/096452 A1 & CN 101925636 A & KR 10-2010-0119874 A & TW 200940598 A	1-7
P, A	JP 2012-255148 A (富士フイルム株式会社) 2012. 12. 27, 【特許請求の範囲】、段落【0035】【0043】 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 2005-118723 A (三洋化成工業株式会社) 2005. 05. 12, 【請求項5】、段落【0009】 (ファミリーなし)	1-7